PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2001-100412

(43) Date of publication of application: 13.04.2001

(51)Int.CI.

7/031 GO3F C08F 2/46 GO3F 7/00 GO3F 7/027 GO3F 7/029

(21)Application number: 11-280204

(71)Applicant: FUJI PHOTO FILM CO LTD

(22)Date of filing:

30.09.1999

(72)Inventor: MUROTA YASUBUMI

SORORI TADAHIRO

(54) PHOTOSENSITIVE COMPOSITION

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain a photosensitive composition excellent in work efficiency, profitableness and preservation stability, usable as a material of an original plate for a planographic printing plate for scanning exposure adaptable to a CTP system or a planographic printing plate having high sensitivity to the oscillation wavelength of a low-cost shortwave semiconductor laser and using a new photopolymerization initiating system having high sensitivity in the wide wavelength range of 350-450 nm. SOLUTION: The photosensitive composition contains (i) a sensitizing dye of formula 1, e. g. a compound of formula 2, (ii) a titanocene compound and (iii) a compound which reacts under a radical or acid, varies its physical or chemical characteristics and retains the varied characteristics.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection] [Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(12)公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開2001-100412A) (P2001-100412A) (43)公開日 平成13年4月13日(2001.4.13)

(51)Int. C1.	7	識別記号			FΙ			テーマコード(参	考)
G 0 3 F	7/031				G 0 3 F	7/031		2H025	
C 0 8 F	2/46				C 0 8 F	2/46		2H096	
G 0 3 F	7/00	503			G 0 3 F	7/00	503	4J011	
	7/027					7/027			
	7/029					7/029			
	審査請求	未請求 請求項	の数3	OL			(全26	(頁)	
(21)出願番号	杜杨	頭平11-280204			(71)UES 1	0000050	001		
(21)山城田で	171	KR-1-11-200204			(71)出願人			4-A A 11	
(99\mgg tr	777	· 11年0日20日/10	100 0 00)				ミフイルムを		
(22)出願日	'1' ,	成11年9月30日(19	99.9.30)		(=0) m == +-			中沼210番地	
					(72)発明者	室田			
				- 1				订川尻4000番地	富士写
						真フイノ	レム株式会社	土内	
					(72)発明者	曽呂利	忠弘		
						静岡県植	秦原郡吉田田	订川尻4000番地	富士写
						真フイノ	レム株式会社	土内	
					(74)代理人	1000738	74		
						弁理士	萩野 平	(外4名)	
								最終記	頁に続く
				1					

(54) 【発明の名称】感光性組成物

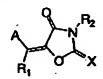
(57)【要約】 (修正有)

【課題】 作業性、経済性、保存安定性に優れ、CTPシステムに適合した走査露光用平版印刷版または安価な短波半導体レーザの発振波長に対し高感度な平版印刷版用原版の材料として用いることができ、広く350nmから450nmの波長に対し高感度な新規な光重合開始*

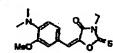
*系を用いる感光性組成物の提供。 P 【解決手段】 (i) 下記の一般は

【解決手段】(i)下記の一般式(1)で表される増感色素、(ii)チタノセン化合物、(iii)ラジカルおよび酸のいずれかによって反応し、その物理的および化学的特性のいずれかが変化して保持される化合物を含有する感光性組成物。

一般式 (1)



例えば



【特許請求の範囲】

【請求項1】(i)下記一般式(1)で表される増感色 素、(ii)チタノセン化合物、(iii)ラジカルお よび酸の少なくともいずれかによって反応し、その物理 的および化学的特性の少なくともいずれかが変化して保 持される化合物を含有する感光性組成物。

【化1】

(一般式(1)中、Aは置換基を有しても良い芳香族環またはヘテロ環をあらわし、Xは酸素原子又は硫黄原子ないし-N(R_s) -をあらわす。 R_1 、 R_2 および R_3 は、それぞれ独立に、水素原子または、一価の非金属原子団であり、Aと R_1 及び R_2 と R_3 はそれぞれ互いに、脂肪族性または芳香族性の環を形成するため結合することができる。)

【請求項2】 前記ラジカルおよび酸の少なくともいずれかによって反応し、その物理的および化学的特性の 20 少なくともいずれかが変化して保持される化合物がエチレン性不飽和二重結合を有する付加重合性化合物である請求項1記載の感光性組成物。

【請求項3】 請求項1記載の感光性組成物を450 nm以下の波長を有するレーザー光で露光することを特 徴とする光重合方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は新規な光開始系、特に、高感度でかつ、安定性に優れた光開始系を含有する感光性組成物に関する。また、本発明は、特に、ディジタル信号に基づいた走査露光により製版可能な平版印刷版用原版の材料として優れた感光性組成物に関する。さらに、例えば、光造形、ホログラフィー、カラーハードコピーといった画像形成や、フォトレジスト等の電子材料製造分野、インクや塗料、接着剤等の光硬化樹脂材料用途に利用される。

[0002]

【従来の技術】従来、平版印刷版としては親水性支持体上に親油性の感光性樹脂層を設けた構成を有するPS版 40 が広く用いられ、その製版方法として、通常は、リスフイルムを介してマスク露光 (面露光)後、非画像部を溶解除去することにより所望の印刷版を得ていた。

【0003】近年、画像情報をコンピュータを用いて電子的に処理、蓄積、出力する、ディジタル化技術が広く普及し、それに対応した新しい画像出力方式が種々実用される様になってきた。その結果レーザ光のような指向性の高い光をディジタル化された画像情報に従って走査し、リスフイルムを介す事無く、直接印刷版を製造するコンピュータートゥープレート(CTP)技術が望ま

れ、これに適応した印刷版用原版を得ることが重要な技 術課題となっている。

【0004】このような走査露光可能な平版印刷版を得る方式の一つとして、従来より、親水性支持体上にもうけるインク受容性の感光性樹脂層(以下、感光層という)として、感光スピードに優れた光重合系組成物を用いた構成が提案され、既に上市されている。該構成の原版は、現像処理が簡便であり、さらに解像度、着肉性、耐刷性、汚れ性に優れるといった望ましい刷版、印刷性10 能を有する。

【0005】上記、光重合性組成物は基本的にはエチレン性不飽和化合物、光重合開始系、パインダー樹脂からなり、画像形成は、光開始系が光吸収し、活性ラジカルを生成、エチレン性不飽和化合物の付加重合を引き起こし、感光層の不溶化を生じるものである。従来の、走査器光可能な光重合性組成物に関する提案の大部分は、感光性に優れた光開始系の使用を開示したものであり、例えば、Bruce M. Monroeら著、Chemical Revue,93,435(1993).やR.S.Davidson著、Journal of Photochemistry and biology A:Chemistry,73.81(1993).に多く記載されている。

【0006】これらの光開始系からなる光重合性組成物と光源としてArレーザー(488nm)やFD-YAGレーザー(532nm)の様な長波長の可視光源を用いた、従来のCTPシステムに関しては、製版行程の生産性をあげるために、さらに高速で書き込む事が望まれているが、光源の出力が十分高くないことや感材の感度が十分高く無い為に到達されていない。

【0007】一方、近年、例えば、InGaN系の材料を用い、350nmから450nm域で連続発振可能な半導体レーザが実用段階となっている。これらの短波光源を用いた走査露光システムは、半導体レーザが構造上、安価に製造出来るため、十分な出力を有しながら、経済的なシステムを構築できるといった長所を有する。さらに、従来のFD-YAGやArレーザを使用するシステムに比較して、より明るいセーフライト下での作業が可能な感光域が短波な感材が使用できる。

【0008】さらに、例えば、J.P.Faussier "Photoini tiated Polymerization-Theory andApplications": Rap ra Review vol.9, Report,Rapra Technology(1998).やM.Tsunooka et al.,Prog.Polym.Sci.,21,1(1996).に記載されるように、感度の高い光開始系を得る事は、広く、イメージング分野において尚、切望される技術である。

【0009】しかしながら、350nmから450nm の短波長域で走査露光に十分な感度を有する光開始系は 現在までに知られていない。

【0010】従来、比較的感度の高い光開始系として特定の色素とチタノセン化合物の組み合わせた開始系が開 50 示されている。特公昭61-9621では、オキサゾリ

ジン酸性核を有する色素とトリアジン光開始剤との組み 合わせが開示されているが、保存安定性が悪く、製造上 問題があった。また、特開平8-272096では、オ キサゾロン酸性核を有する色索とチタノセンの組み合わ せが、特開平10-101719では、5員へテロ環酸 性核を有する色索とチタノセンの組み合わせが開示され ている。これらは確かに高感度であったが十分でなく、 また、450nm以下の波長を有するレーザー光源を用 いた場合には実用上十分な感度が得られず、短波長光源 には適さない。

[0011]

【発明が解決しようとする課題】本発明の目的は、作業 性、経済性、保存安定性に優れた、CTPシステムに適 合した走査露光用平版印刷版または安価な短波半導体レ ーザの発振波長に対し高感度な平版印刷版用原版の材料 として用いられる感光性組成物を提供する事にある。ま た、本発明の他の目的は、広く350nmから450n mの波長に対し高感度な新規な光重合開始系を用いる感 光性組成物を提供することにある。

[0012]

【課題を解決するための手段】本発明者らは、上記目的 を達成すべく鋭意検討を重ねた結果、(i)一般式 (1) で表される増感色素、(ii) チタノセン化合 物、(iii)ラジカルおよび酸の少なくともいずれか によって反応し、その物理的および化学的特性の少なく ともいずれかが変化して保持される化合物を含有する構 成を用いることで、短波半導体レーザの発振波長に対し て十分な感度を有し、しかも、保存安定性に優れた感光 性組成物が得られることを見いだし、本発明に到達した ものである。

[0013]

【化2】

【0014】(一般式(1)中、Aは置換基を有しても 良い芳香族環またはヘテロ環をあらわし、Xは酸素原子 又は硫黄原子ないし-N(R₃)-をあらわす。R₁、R 2およびR3は、それぞれ独立に、水素原子または、一価 40 の非金属原子団であり、AとR₁及びR₂と R₃はそれ ぞれ互いに、脂肪族性または芳香族性の環を形成するた め結合することができる。)

[0015]

【発明の実施の形態】本発明の実施の形態について詳細 に説明する。本発明の感光性組成物は、(A)光重合開 始系、(B)少なくとも一個の、ラジカルおよび酸の少 なくともいずれかによって反応し、その物理的および化 学的特性の少なくともいずれかが変化して保持される化 合物を必須成分とし、さらに必要に応じ、(C)パイン 50 ダーポリマーを含んで成る。以下、これらの成分につい て具体的に説明する。

【0016】(A)光重合開始系

本発明の感光性組成物の必須成分である光重合開始系は (I)特定構造を有する増感色素と(II)チタノセン化合物 を含有する。本発明における開始系は、主として増感色 索が光吸収し、共存するチタノセン化合物からの開始ラ ジカル発生を促進するものと考えられる (この様なプロ セスを以下、色素増感という)。本発明の増感色索が特 10 に優れる一つの理由は、その吸収波長が350から45 0 nm域であることにある。また、後述するチタノセン 化合物の多くは、それ自体、紫外から500mm付近ま での波長域に弱い吸収を持ち、そこでも感光性を有する が、本発明の特定構造の増感色素はチタノセンの感光性 を著しく向上せしめるため、例えばチタノセン化合物の 使用量を比較的少量にとどめることで、短波での感光性 を十分に高めながら、同時に、チタノセン自体による5 00 nm域での感光性を低感度にすることが可能であ り、セーフライト適性の向上が図れる。

【0017】本発明者らは、増感色素が次のような構造 上の特徴を満たす場合に、上記のような特性が得られる ことを見出し、本発明に至った。すなはち、色素の酸性 核がカルボニル基またはチオカルボニル基を一つ以上有 するオキサゾリジノン5員環構造を持ち、かつ、塩基性 核が芳香族環またはヘテロ環を有する場合に非常に高い 感度と優れた吸収特性が得られることが判明した。ここ で、"酸性核"、"塩基性核"の定義は、T. H. James, "The Theory of The Photographic Process" fourth ed ition, Macmillanの第8章に記載されている。メロシア 30 ニンに代表される増感色素は、一般的に1)塩基性(電 子供与性) および2)酸性(電子受容性)のヘテロ環を 末端に有するが、1)の塩基性(電子供与性)ヘテロ環 を塩基性核、2)の酸性(電子受容性)ヘテロ環を酸性 核と呼ぶ。酸性核、塩基性核の例は先述のT. H. James、 "The Theory of The Photographic Process" fourth e dition, Macmillanの第8章に多数記載されている。

【0018】本発明における特定構造の増感色素が特に 色素増感能に優れる理由は色素増感の機構が不明のた め、詳述する事はできないが、以下の様に考えることが できる。すなわち、本発明の増感色素は高強度の発光 (ケイ光および又はリン光) スペクトルを示す。このこ とから、一つの可能性として、上記部分構造を有する本 発明の増感色素は励起状態の寿命が比較的長いため、活 性剤との反応を、効率化するように作用していることが 考えられる。

【0019】(A1)增感色索

本発明に用いられる増感色索は下記一般式 (1) であら わされるものである。

[0020]

【化3】

【0021】(一般式(1)中、Aは置換基を有しても 良い芳香族環またはヘテロ環をあらわし、Xは酸素原子 又は硫黄原子ないし-N(R_s)-をあらわす。R₁、R 2およびR3は、それぞれ独立に、水緊原子または、一価 の非金属原子団であり、AとR1及びR2と R3はそれ それ互いに、脂肪族性または芳香族性の環を形成するた 10 め結合することができる。)

【0022】一般式(1)について詳しく説明する。R 1、R2およびR3は、それぞれ独立に、水素原子また は、一価の非金属原子団であり、好ましくは、置換もし くは非置換のアルキル基、置換もしくは非置換のアルケ ニル基、置換もしくは非置換のアリール基、置換もしく は非置換の芳香族複素環残基、置換もしくは非置換のア ルコキシ基、置換もしくは非置換のアルキルチオ基、ヒ ドロキシル基、ハロゲン原子を表す。

【0023】R1、R2およびR3の好ましい例について 具体的に述べる。好ましいアルキル基の例としては、炭 索原子数が1から20までの直鎖状、分岐状、および環 状のアルキル基を挙げることができ、その具体例として は、メチル基、エチル基、プロビル基、ブチル基、ペン チル基、ヘキシル基、ヘプチル基、オクチル基、ノニル 基、デシル基、ウンデシル基、ドデシル基、トリデシル 基、ヘキサデシル基、オクタデシル基、エイコシル基、 イソプロピル基、イソブチル基、s-ブチル基、t-ブ チル基、イソペンチル基、ネオペンチル基、1-メチル ブチル基、イソヘキシル基、2-エチルヘキシル基、2 ーメチルヘキシル基、シクロヘキシル基、シクロペンチ ル基、2-ノルボルニル基を挙げることができる。これ らの中では、炭素原子数1から12までの直鎖状、炭素 原子数3から12までの分岐状、ならびに炭素原子数5 から10までの環状のアルキル基がより好ましい。

【0024】置換アルキル基の置換基としては、水素を 除く一価の非金属原子団が用いられ、好ましい例として は、ハロゲン原子(-F, -Br, -Cl, -I)、ヒ ドロキシル基、アルコキシ基、アリーロキシ基、メルカ プト基、アルキルチオ基、アリールチオ基、アルキルジ チオ基、アリールジチオ基、アミノ基、N-アルキルア ミノ基、N, N-ジアルキルアミノ基、N-アリールア ミノ基、N,N-ジアリールアミノ基、N-アルキルー N-アリールアミノ基、アシルオキシ基、カルバモイル オキシ基、N-アルキルカルバモイルオキシ基、N-ア リールカルバモイルオキシ基、N,N-ジアルキルカル パモイルオキシ基、N、N-ジアリールカルバモイルオ キシ基、N-アルキル-N-アリールカルバモイルオキ シ基、アルキルスルホキシ基、アリールスルホキシ基、

ミノ基、N-アリールアシルアミノ基、ウレイド基、 N′-アルキルウレイド基、N′, N′-ジアルキルウ レイド基、

【0025】N′-アリールウレイド基、N′, N′-ジアリールウレイド基、N′-アルキル-N′-アリー ルウレイド基、N-アルキルウレイド基、N-アリール ウレイド基、N´-アルキル-N-アルキルウレイド 基、N′-アルキル-N-アリールウレイド基、N′, N' -ジアルキル-N-アルキルウレイド基、N', N′-ジアルキル-N-アリールウレイド基、N′-ア リールーN-アルキルウレイド基、N'-アリール-N -アリールウレイド基、N´, N´-ジアリール-N-アルキルウレイド基、N´, N´ージアリール-N-ア リールウレイド基、N′-アルキル-N′-アリール-N-アルキルウレイド基、N'-アルキル-N'-アリ ールーN-アリールウレイド基、アルコキシカルポニル アミノ基、アリーロキシカルポニルアミノ基、N-アル キルーN-アルコキシカルポニルアミノ基、N-アルキ ルーN-アリーロキシカルポニルアミノ基、N-アリー 20 ルーN-アルコキシカルボニルアミノ基、N-アリール -N-アリーロキシカルポニルアミノ基、ホルミル基、 アシル基、カルポキシル基、

【0026】アルコキシカルポニル基、アリーロキシカ ルポニル基、カルバモイル基、N-アルキルカルバモイ ル基、N,N-ジアルキルカルパモイル基、N-アリー ルカルバモイル基、N、N-ジアリールカルバモイル 基、N-アルキル-N-アリールカルバモイル基、アル キルスルフィニル基、アリールスルフィニル基、アルキ ルスルホニル基、アリールスルホニル基、スルホ基 (-SО₃Н) 及びその共役塩基基 (以下、スルホナト基と 称す)、アルコキシスルホニル基、アリーロキシスルホ ニル基、スルフィナモイル基、N-アルキルスルフィナ モイル基、N,N-ジアルキルスルフィナモイル基、N -アリールスルフィナモイル基、N, N-ジアリールス ルフィナモイル基、N-アルキル-N-アリールスルフ ィナモイル基、スルファモイル基、N-アルキルスルフ ァモイル基、N, N-ジアルキルスルファモイル基、N -アリールスルファモイル基、N, N-ジアリールスル ファモイル基、N-アルキル-N-アリールスルファモ イル基、ホスフォノ基(-PO3H2)及びその共役塩基 基(以下、ホスフォナト基と称す)、

【0027】ジアルキルホスフォノ基 (-PO₃(alkyl) 2) 、ジアリールホスフォノ基 (-PO₃(aryl)₂)、ア ルキルアリールホスフォノ基 (-PO₃(alkyl)(ary 1))、モノアルキルホスフォノ基 (-PO₃H(alkyl)) 及びその共役塩基基(以後、アルキルホスフォナト基と 称す)、モノアリールホスフォノ基 (-PO₃H(ary 1)) 及びその共役塩基基 (以後、アリールホスフォナト 基と称す)、ホスフォノオキシ基(- 〇P〇3H2)及び アシルチオ基、アシルアミノ基、N-アルキルアシルア 50 その共役塩基基 (以後、ホスフォナトオキシ基と称

す)、ジアルキルホスフォノオキシ基(-OPOs(alky l)s)、ジアリールホスフォノオキシ基(-OPOs(ary l)s)、アルキルアリールホスフォノオキシ基(-OPOs(alkyl)(aryl))、モノアルキルホスフォノオキシ基(-OPOsH(alkyl))及びその共役塩基基(以後、アルキルホスフォナトオキシ基と称す)、モノアリールホスフォノオキシ基(-OPOsH(aryl))及びその共役塩基基(以後、アリールフォスホナトオキシ基と称す)、シアノ基、ニトロ基、アリール基、ヘテロアリール基、アルケニル基、アルキニル基が挙げられる。

【0028】これらの置換基における、アルキル基の具 体例としては、前述のアルキル基が挙げられ、アリール 基の具体例としては、フェニル基、ビフェニル基、ナフ チル基、トリル基、キシリル基、メシチル基、クメニル 基、クロロフェニル基、プロモフェニル基、クロロメチ ルフェニル基、ヒドロキシフェニル基、メトキシフェニ ル基、エトキシフェニル基、フェノキシフェニル基、ア セトキシフェニル基、ベンゾイロキシフェニル基、メチ ルチオフェニル基、フェニルチオフェニル基、メチルア ミノフェニル基、ジメチルアミノフェニル基、アセチル アミノフェニル基、カルポキシフェニル基、メトキシカ ルポニルフェニル基、エトキシフェニルカルポニル基、 フェノキシカルボニルフェニル基、N-フェニルカルバ モイルフェニル基、フェニル基、シアノフェニル基、ス ルホフェニル基、スルホナトフェニル基、ホスフォノフ エニル基、ホスフォナトフェニル基等を挙げることがで きる。

【0029】ヘテロアリール基としては、窒素、酸素、硫黄原子の少なくとも一つを含有する単環、もしくは多環芳香族環が用いられ、特に好ましいヘテロアリール基 30の例としては、例えば、チオフェン、チアスレン、フラン、ピラン、イソベンゾフラン、クロメン、キサンテン、フェノキサジン、ピロール、ピラゾール、イソチアゾール、イソオキサゾール、ピラジン、ピリミジン、ピリダジン、インドリジン、イソインドリジン、インドイール、インダゾール、プリン、キナゾリン、シノリン、フタラジン、ナフチリジン、カルバゾール、カルボリン、フェナンスリン、アクリジン、ペリミジン、フェナンスロリン、フタラジン、フェナルザジン、フェノキサジン、フラザ 40ン、フェノキサジンや等があげられ、これらは、さらにベンゾ縮環しても良く、また置換基を有していても良い。

【0030】また、アルケニル基の例としては、ビニル基、1-プロペニル基、1-プテニル基、シンナミル基、2-クロロー1-エテニル基、等が挙げられ、アルキニル基の例としては、エチニル基、1-プロビニル基、1-プチニル基、トリメチルシリルエチニル基等が挙げられる。アシル基(G_1CO-)における G_1 としては、水索、ならびに上記のアルキル基、アリール基を挙

げることができる。これら置換基の内、更により好まし いものとしてはハロゲン原子(-F、-Br、-C1、 I)、アルコキシ基、アリーロキシ基、、アルキルチ オ基、アリールチオ基、N-アルキルアミノ基、N, N -ジアルキルアミノ基、アシルオキシ基、N-アルキル カルバモイルオキシ基、N-アリールカルバモイルオキ シ基、アシルアミノ基、ホルミル基、アシル基、カルボ キシル基、アルコキシカルポニル基、アリーロキシカル ポニル基、カルバモイル基、N-アルキルカルバモイル 10 基、N, N-ジアルキルカルバモイル基、N-アリール カルバモイル基、N-アルキル-N-アリールカルバモ イル基、スルホ基、スルホナト基、スルファモイル基、 N-アルキルスルファモイル基、N, N-ジアルキルス ルファモイル基、N-アリールスルファモイル基、N-アルキルーN-アリールスルファモイル基、ホスフォノ 基、ホスフォナト基、ジアルキルホスフォノ基、ジアリ ールホスフォノ基、モノアルキルホスフォノ基、アルキ ルホスフォナト基、モノアリールホスフォノ基、アリー ルホスフォナト基、ホスフォノオキシ基、ホスフォナト オキシ基、アリール基、アルケニル基が挙げられる。

【0031】一方、置換アルキル基におけるアルキレン基としては前述の炭素数1から20までのアルキル基上の水素原子のいずれか1つを除し、2価の有機残基としたものを挙げることができ、好ましくは炭素原子数1から12までの直鎖状、炭素原子数3から12までの分岐状ならびに炭素原子数5から10までの環状のアルキレン基を挙げることができる。

【0032】該置換基とアルキレン基を組み合わせる事 により得られるR₁、R₂およびR₃として好ましい置換 アルキル基の、具体例としては、クロロメチル基、プロ モメチル基、2-クロロエチル基、トリフルオロメチル 基、メトキシメチル基、メトキシエトキシエチル基、ア リルオキシメチル基、フェノキシメチル基、メチルチオ メチル基、トリルチオメチル基、エチルアミノエチル 基、ジエチルアミノプロビル基、モルホリノプロヒル 基、アセチルオキシメチル基、ベンゾイルオキシメチル 基、N-シクロヘキシルカルバモイルオキシエチル基、 N-フェニルカルパモイルオキシエチル基、アセチルア ミノエチル基、N-メチルペンゾイルアミノプロピル 基、2-オキソエチル基、2-オキソプロビル基、カル ボキシプロピル基、メトキシカルボニルエチル基、アリ ルオキシカルポニルブチル基、クロロフェノキシカルポ ニルメチル基、カルバモイルメチル基、N-メチルカル パモイルエチル基、N,N-ジプロピルカルパモイルメ チル基、N-(メトキシフェニル) カルバモイルエチル 基、N-メチル-N- (スルホフェニル) カルパモイル メチル基、

基、1-ブチニル基、トリメチルシリルエチニル基等が 【0033】スルホブチル基、スルホナトブチル基、ス 挙げられる。アシル基(G_1CO-)における G_1 として ルファモイルブチル基、N-エチルスルファモイルメチ は、水索、ならびに上記のアルキル基、アリール基を挙 50 ル基、N, N-ジプロビルスルファモイルプロビル基、 Nートリルスルファモイルプロビル基、NーメチルーNー (ホスフォノフェニル) スルファモイルオクチル基、ホスフォノブチル基、ホスフォナトへキシル基、ジエチルホスフォノブチル基、ジフェニルホスフォノブロビル基、メチルホスフォノブチル基、メチルホスフォナトブチル基、トリルホスフォナトブチル基、トリルホスフォナトブラット。カーメチル基、ホスフォノオキシブロビル基、ホスフォナトオキシブチル基、ベンジル基、フェネチル基、スフォチルベンジル基、1ーメチルー1ーフェニルエチル基、 α ーメチルベンジル基、シンナミル基、アリル基、1ープロペニルメチル基、2ーズテニル基、2ーメチルアリル基、2ーメチルプロペニルメチル基、2ーブロビニル基、2ーブチニル基、第を挙げることができる。

【0034】R₁、R₂およびR₃として好ましいアリール基の具体例としては、1個から3個のベンゼン環が縮合環を形成したもの、ベンゼン環と5員不飽和環が縮合環を形成したものを挙げることができ、具体例としては、フェニル基、ナフチル基、アントリル基、フェナントリル基、インデニル基、アセナフテニル基、フルオレニル基、を挙げることができ、これらのなかでは、フェニル基、ナフチル基がより好ましい。

【0035】R1、R2およびR3として好ましい置換ア リール基の具体例としては、前述のアリール基の環形成 炭素原子上に置換基として、水素を除く一価の非金属原 子団を有するものが用いられる。好ましい置換基の例と しては前述のアルキル基、置換アルキル基、ならびに、 先に置換アルキル基における置換基として示したものを 挙げることができる。この様な、置換アリール基の好ま しい具体例としては、ピフェニル基、トリル基、キシリ ル基、メシチル基、クメニル基、クロロフェニル基、ブ ロモフェニル基、フルオロフェニル基、クロロメチルフ ェニル基、トリフルオロメチルフェニル基、ヒドロキシ フェニル基、メトキシフェニル基、メトキシエトキシフ ェニル基、アリルオキシフェニル基、フェノキシフェニ ル基、メチルチオフェニル基、トリルチオフェニル基、 エチルアミノフェニル基、ジエチルアミノフェニル基、 モルホリノフェニル基、アセチルオキシフェニル基、ベ ンゾイルオキシフェニル基、N-シクロヘキシルカルバ モイルオキシフェニル基、N-フェニルカルバモイルオ 40 キシフェニル基、

【0036】アセチルアミノフェニル基、N-メチルベ ンゾイルアミノフェニル基、カルボキシフェニル基、メ トキシカルポニルフェニル基、アリルオキシカルポニル フェニル基、クロロフェノキシカルポニルフェニル基、 カルパモイルフェニル基、N-メチルカルバモイルフェ ニル基、N, N-ジプロビルカルバモイルフェニル基、 N- (メトキシフェニル) カルパモイルフェニル基、N **ーメチルーNー (スルホフェニル) カルバモイルフェニ** 10 ル基、スルホフェニル基、スルホナトフェニル基、スル ファモイルフェニル基、N-エチルスルファモイルフェ ニル基、N,N-ジプロピルスルファモイルフェニル 基、N-トリルスルファモイルフェニル基、N-メチル -N-(ホスフォノフェニル)スルファモイルフェニル 基、ホスフォノフェニル基、ホスフォナトフェニル基、 ジエチルホスフォノフェニル基、ジフェニルホスフォノ フェニル基、メチルホスフォノフェニル基、メチルホス フォナトフェニル基、トリルホスフォノフェニル基、ト リルホスフォナトフェニル基、アリル基、1-プロペニ 20 ルメチル基、2-プテニル基、2-メチルアリルフェニ ル基、2-メチルプロペニルフェニル基、2-プロビニ ルフェニル基、2-ブチニルフェニル基、3-ブチニル フェニル基、等を挙げることができる。

【0037】次に、一般式(1)におけるAについて説明する。Aは置換基を有しても良い芳香族環またはヘテロ環をあらわし、置換基を有しても良い芳香族環またはヘテロ環の具体例としては、一般式(1)中のR1、R2およびR3で記載したものと同様のものが挙げられる。【0038】本発明の一般式であらわされる増感色素は、上に示したような酸性核や、活性メチレン基を有る酸性核と、置換、もしくは非置換の、芳香族環またはヘテロ環との縮合反応によって得られるが、これらは特公昭59-28329を参照して合成することができる。以下に一般式(1)で表される化合物の好ましい具体例(D1)から(D28)を示すが、本発明はこれに限定されるものではない。また、酸性核と塩基性核を結ぶ2重結合による異性体については明らかでなく、本発明はどちらかの異性体に限定されるものでもない。

[0039]

【化4】

[0040]

【化5】

[0041]

【化6】

[0042]

なる。

【0043】本発明の増感色素に関しては、さらに、平版印刷版用原版とした場合、その感光層の特性を改良するための様々な化学修飾を行うことも可能である。例えば、増感色素と、付加重合性化合物構造(例えば、アクリロイル基やメタクリロイル基)とを、共有結合、スクリロイル基やメタクリロイル基)とを、共有結合、露光膜の高強度化や、露光後の膜からの色素の不要な析出抑制を行う事ができる。また、増感色素と後述のチタノセン化合物やその他のラジカル発生パート(例えば、ハロゲン化アルキル、オニウム、過酸化物、ピイミダゾール、オニウム、ビイミダゾール等の還元分解性部位や、ボレート、アミン、トリメチルシリルメチル、カルボニル、イミン等の酸化解裂性部位)との結合により、特に開始系の濃度の低い状態での感光性を著しく高める事ができる。

【0044】さらに、本発明の感光性組成物を用いて平 版印刷版用原版とした場合、その感光層の好ましい使用 様態である、 (アルカリ) 水系現像液への処理適性を高 める目的に対しては、親水性部位(カルボキシル基並び にそのエステル、スルホン酸基並びにそのエステル、エ チレンオキサイド基等の酸基もしくは極性基) の導入が 有効である。特にエステル型の親水性基は、該感光層中 では比較的疎水的構造を有するため相溶性に優れ、か つ、現像液中では、加水分解により酸基を生成し、親水 性が増大するという特徴を有する。その他、例えば、該 感光層中での相溶性向上、結晶析出抑制のために適宜置 換基を導入する事ができる。例えば、ある種の感光系で は、アリール基やアリル基等の不飽和結合が相溶性向上 に非常に有効である場合があり、また、分岐アルキル構 造導入等の方法により、色素π平面間の立体障害を導入 30 する事で、結晶析出が著しく抑制できる。また、ホスホ ン酸基やエポキシ基、トリアルコキシシリル基等の導入 により、金属や金属酸化物等の無機物への密着性を向上 させる事ができる。そのほか、目的に応じ、増感色素の ポリマー化等の方法も利用できる。

【0045】これらの増感色素のどの構造を用いるか、単独で使用するか2種以上併用するか、添加量はどうか、といった使用法の詳細は、最終的な感材の性能設計にあわせて適宜設定できる。例えば、増感色素を2種以上併用することで、感光性組成物層への相溶性を高める40事ができる。増感色素の選択は、感光性の他、使用する光源の発光波長でのモル吸光係数が重要な因子である。モル吸光係数の大きな色素を使用する事により、色素の添加量は比較的少なくできるので、経済的であり、かつ平版印刷版用原版に用いた場合、その感光層の膜物性の点からも有利である。該感光層の感光性、解像度や、露光膜の物性は光源波長での吸光度に大きな影響を受けるので、これらを考慮して増感色素の添加量を適宜選択する。例えば、吸光度が0.1以下の低い領域では感度が低下する。また、ハレーションの影響により低解像度と50

【0046】但し、例えば5µm以上の厚い膜を硬化せしめる目的に対しては、この様な低い吸光度の方がかえって硬化度をあげられる場合もある。また、吸光度が3以上の様な高い領域では、上記感光層表面で大部分の光が吸収され、より内部での硬化が阻害され、例えば印刷版として使用した場合には膜強度、基板密着性の不十分なものとなる。比較的薄い膜厚で使用する平版印刷版としての使用に際しては、増感色素の添加量は、感光層の吸光度が0.1から1.5の範囲、好ましくは0.25から1の範囲となるように設定するのが好ましい。平版印刷版として利用する場合には、これは、通常、感光層成分100重量部に対し、0.05~30重量部、好ましくは0.1~20重量部、さらに好ましくは0.2~10重量部の範囲である。

18

【0047】(A2) チタノセン化合物

本発明において光重合性開始系として用いられるチタノセン化合物は、前記した増感色素との共存下で光照射した場合、活性ラジカルを発生し得るチタノセン化合物であればいずれであってもよく、例えば、特開昭 59-152396号、特開昭 61-151197号、特開昭 63-41483号、特開昭 63-41484号、特開平 2-249号、特開平 2-291号、特開平 3-27393号、特開平 3-12403号、特開平 3-12403号、特用平 3-12403号、

【0048】さらに具体的には、ジーシクロペンタジェ ニルーTi-ジークロライド、ジーシクロペンタジエニ ルーTiーピスーフェニル、ジーシクロペンタジエニル -Ti-LZ-2, 3, 4, 5, 6-ZZ-2ェニー1-4ル(以下「T-1」ともいう。)、ジーシ クロペンタジエニルーTi-ピス-2, 3, 5, 6-デ トラフルオロフェニー1ーイル、ジーシクロペンタジェ ニルーTi-ピスー2, 4,6-トリフルオロフェニー 1-イル、ジーシクロペンタジエニル-Ti-ビス-2,6-ジフルオロフエニー1-イル、ジーシクロペン タジエニルーTiーピスー2, 4-ジフルオロフエニー 1-イル、ジーメチルシクロペンタジエニル-Ti-ビ イル、ジーメチルシクロペンタジエニルーTi-ビスー 2, 3, 5, 6-テトラフルオロフエニー1-イル、ジ ーメチルシクロペンタジエニル-Ti-ビス-2, 4-ジフルオロフエニー1ーイル、ピス (シクロペンタジェ ニル)-ピス(2,6-ジフルオロ-3-(ピル-1-イル)フェニル) チタニウム (以下「T-2」ともい う。) 等を挙げることができる。

光膜の物性は光源波長での吸光度に大きな影響を受ける 【0049】本発明のチタノセン化合物に関しても、先ので、これらを考慮して増感色素の添加量を適宜選択す の増感色素と同様、さらに、平版印刷版用原版とした場る。例えば、吸光度が0.1以下の低い領域では感度が 合、その感光層の特性を改良するための様々な化学修飾低下する。また、ハレーションの影響により低解像度と 50 を行うことも可能である。例えば、増感色素や、付加重

合性不飽和化合物その他のラジカル発生パートとの結 合、親水性部位の導入、相溶性向上、結晶析出抑制のた めの置換基導入、密着性を向上させる置換基導入、ポリ マー化等の方法が利用できる。

【0050】これらのチタノセン化合物の使用法に関し ても、先述の付加重合性化合物、増感色素同様、感材の 性能設計により適宜、任意に設定できる。例えば、2種 以上併用することで、感光性組成物層への相溶性を高め る事ができる。チタノセン化合物の使用量は通常多い方 が感光性の点で有利であり、感光層成分100重量部に 10 対し、0.5~80重量部、好ましくは1~50重量 部、範囲で用いることで十分な感光性が得られる。一 方、本発明の主要な目的である、黄色等、白色灯化での 使用に際しては、500nm付近の光によるカブリ件の 点からチタノセンの使用量は少ない事が好ましいが、本 発明の増感色索との組み合わせによりチタノセンの使用 量は6重量部以下、さらに1.9重量部以下、さらには 1. 4 重量部以下にまで下げても十分な感光性を得るこ とができる。

【0051】(B)少なくとも一個の、ラジカルおよび 20 酸の少なくともいずれかによって反応し、その物理的お よび化学的特性の少なくともいずれかが変化して保持さ れる化合物

本発明に於ける第3の必須成分 (i i i) は上述の光開 始系の光反応により生じた、活性種の作用により、その 物理的もしくは化学的特性が変化して保持される化合物 であり、成分(iii)は、このような性質を有するも のであれば特に制限なく任意のものを使用でき、例え ば、上述の開始系にあげた化合物自身がそのような性質 を有する場合も多い。光開始系から生成したラジカル、 酸、および/または塩基により、変化する成分 (ii i)の特性としては、例えば、吸収スペクトル(色)、 化学構造、分極率等の分子的な物性や、溶解性、強度、 屈折率、流動性、粘着性、等の材料的な物性の変化を含 tr.

【0052】例えば、成分 (i i i) として、pH指示 薬のように、pHによって吸収スペクトルの変化する化 合物を用い、開始系から酸または塩基を発生させれば、 露光部のみの色味をかえる事ができるが、この様な組成 物は画像形成材料として有用である。同様に、(ii i)として、酸化・還元や求核付加反応により吸収スペ クトルが変化する化合物を用いた場合、開始系から生成 するラジカルによる酸化、還元等を引き起こし画像形成 が可能である。そのような例は例えば、

J.Am.Chem.Soc., <u>108</u>, 128(1986). J.Imaging.Sci., <u>30</u>, 2 15(1986).

Israel.J.Chem., 25, 264(1986).

に開示されている。

【0053】また、(iii)として付加重合または、 重縮合可能な化合物を用い、開始系と組み合わせる事に 50 ル、アミド類と単官能もしくは多官能のアルコール類、

より、光硬化性樹脂、あるいはネガ型フォトポリマーを 形成可能である。(iii)としては、ラジカル重合性 化合物 (エチレン性不飽和結合を有する化合物等) やカ チオン重合性化合物(エポキシ化合物、ビニルエーテル 化合物、メチロール化合物等)、アニオン重合性化合物 (エポキシ化合物等) が用いられ、そのような例は、例 えば、フォトポリマー懇話会編、フォトポリマーハンド ブック、工業調査会(1989)や、高分子,45,786(19 96).等に記載される。また、(iii)としてチオール 化合物を用い、光ラジカル発生系と組み合わせた組成物 も良く知られる。

【0054】(iii)として酸分解性の化合物を用 い、光酸発生剤と組み合わせる事も有用である。例え ば、側鎖や、主鎖が酸で分解する高分子を用い、光によ り溶解性や親疎水性等を変化させる材料は光分解型感光 性樹脂、ポジ型フォトポリマーとして広く実用されてい る。そのような具体例は例えば、ACS. Symp. Ser. 242, 11 (1984).、特開昭60-3625、USP-51027 71,5206317,5212047,特開平4-2 6850, 特開平3-1921731, 特開昭60-1 0247, 特開昭62-40450等があげられる。

【0055】以下には本発明の目的の一つである、高感 度な平版印刷版用原版を得る目的に対し特に優れた成分 (iii)である、付加重合可能な化合物に関しより詳 しく述べる。

(B-1) 付加重合性化合物

本発明に使用される好ましい成分 (iii) である、少 なくとも一個のエチレン性不飽和二重結合を有する付加 **重合性化合物は、末端エチレン性不飽和結合を少なくと** 30 も1個、好ましくは2個以上有する化合物から選ばれ る。この様な化合物群は当該産業分野において広く知ら れるものであり、本発明においてはこれらを特に限定無 く用いる事ができる。これらは、例えばモノマー、プレ ポリマー、すなわち2量体、3量体およびオリゴマー、 またはそれらの混合物ならびにそれらの共重合体などの 化学的形態をもつ。モノマーおよびその共重合体の例と しては、不飽和カルポン酸(例えば、アクリル酸、メタ クリル酸、イタコン酸、クロトン酸、イソクロトン酸、 マレイン酸など)や、そのエステル類、アミド類があげ られ、好ましくは、不飽和カルポン酸と脂肪族多価アル コール化合物とのエステル、不飽和カルボン酸と脂肪族 多価アミン化合物とのアミド類が用いられる。また、ヒ ドロキシル基や、アミノ基、メルカプト基等の求核性置 換基を有する不飽和カルポン酸エステル、アミド類と単 官能もしくは多官能イソシアネート類、エポキシ類との 付加反応物、単官能もしくは、多官能のカルボン酸との 脱水縮合反応物等も好適に使用される。

【0056】また、イソシアナト基や、エポキシ基、等 の親電子性置換基を有する、不飽和カルポン酸エステ

アミン類、チオール類との付加反応物、ハロゲン基や、 トシルオキシ基、等の脱離性置換基を有する、不飽和カ ルポン酸エステル、アミド類と単官能もしくは多官能の アルコール類、アミン類、チオール類との置換反応物も 好適である。また、別の例として、上記の不飽和カルボ ン酸の代わりに、不飽和ホスホン酸、スチレン、ピニル エーテル等に置き換えた化合物群を使用する事も可能で ある。

【0057】脂肪族多価アルコール化合物と不飽和カル ボン酸とのエステルのモノマーの具体例としては、アク 10 ネート等がある。 リル酸エステルとして、エチレングリコールジアクリレ ート、トリエチレングリコールジアクリレート、1、3 ープタンジオールジアクリレート、テトラメチレングリ コールジアクリレート、プロピレングリコールジアクリ レート、ネオペンチルグリコールジアクリレート、トリ メチロールプロパントリアクリレート、トリメチロール プロパントリ (アクリロイルオキシプロヒル) エーテ ル、トリメチロールエタントリアクリレート、ヘキサン ジオールジアクリレート、1,4-シクロヘキサンジオ リレート、ペンタエリスリトールジアクリレート、ペン タエリスリトールトリアクリレート、ペンタエリスリト ールテトラアクリレート、ジペンタエリスリトールジア クリレート、ジベンタエリスリトールヘキサアクリレー ト、ソルビトールトリアクリレート、ソルビトールテト ラアクリレート、ソルビトールペンタアクリレート、ソ ルピトールヘキサアクリレート、トリ (アクリロイルオ キシエチル) イソシアヌレート、ポリエステルアクリレ ートオリゴマー等がある。

【0058】メタクリル酸エステルとしては、テトラメ チレングリコールジメタクリレート、トリエチレングリ コールジメタクリレート、ネオペンチルグリコールジメ タクリレート、トリメチロールプロパントリメタクリレ ート、トリメチロールエタントリメタクリレート、エチ レングリコールジメタクリレート、1,3-ブタンジオ ールジメタクリレート、ヘキサンジオールジメタクリレ ート、ペンタエリスリトールジメタクリレート、ペンタ エリスリトールトリメタクリレート、ペンタエリスリト ールテトラメタクリレート、ジペンタエリスリトールジ メタクリレート、ジペンタエリスリトールヘキサメタク 40 リレート、ソルビトールトリメタクリレート、ソルビト ールテトラメタクリレート、ピス (p-(3-メタクリ ルオキシー2-ヒドロキシプロポキシ) フェニル) ジメ チルメタン、ピスー〔p-(メタクリルオキシエトキ シ)フェニル〕ジメチルメタン等がある。

【0059】イタコン酸エステルとしては、エチレング リコールジイタコネート、プロピレングリコールジイタ コネート、1,3-ブタンジオールジイタコネート、 1,4-ブタンジオールジイタコネート、テトラメチレ イタコネート、ソルビトールテトライタコネート等があ

【0060】クロトン酸エステルとしては、エチレング リコールジクロトネート、テトラメチレングリコールジ クロトネート、ペンタエリスリトールジクロトネート、 ソルビトールテトラジクロトネート等がある。

【0061】イソクロトン酸エステルとしては、エチレ ングリコールジイソクロトネート、ペンタエリスリトー ルジイソクロトネート、ソルビトールテトライソクロト

【0062】マレイン酸エステルとしては、エチレング リコールジマレート、トリエチレングリコールジマレー ト、ペンタエリスリトールジマレート、ソルピトールテ トラマレート等がある。

【0063】その他のエステルの例として、例えば、特 公昭46-27926、特公昭51-47334、特開 昭57-196231記載の脂肪族アルコール系エステ ル類や、特開昭59-5240、特開昭59-524 1、特開平2-226149記載の芳香族系骨格を有す ールジアクリレート、テトラエチレングリコールジアク 20 るもの、特開平1-165613記載のアミノ基を含有 するもの等も好適に用いられる。さらに、前述のエステ ルモノマーは混合物としても使用することができる。

> 【0064】また、脂肪族多価アミン化合物と不飽和力 ルボン酸とのアミドのモノマーの具体例としては、メチ レンピスーアクリルアミド、メチレンピスーメタクリル アミド、1,6-ヘキサメチレンピス-アクリルアミ ド、1,6-ヘキサメチレンピス-メタクリルアミド、 ジエチレントリアミントリスアクリルアミド、キシリレ ンピスアクリルアミド、キシリレンピスメタクリルアミ ド等がある。

【0065】その他の好ましいアミド系モノマーの例と しては、特公昭54-21726記載のシクロヘキシレ ン構造を有すものをあげる事ができる。

【0066】また、イソシアネートと水酸基の付加反応 を用いて製造されるウレタン系付加重合性化合物も好適 であり、そのような具体例としては、例えば、特公昭4 8-41708号公報中に記載されている1分子に2個 以上のイソシアネート基を有するポリイソシアネート化 合物に、下記一般式 (2) で示される水酸基を含有する ピニルモノマーを付加させた1分子中に2個以上の重合 性ビニル基を含有するビニルウレタン化合物等が挙げら れる。

[0067]

【化8】

CH2=C(R)COOCH2CH(R')OH (2) 【0068】一般式(2)中、RおよびR'はHあるい はCHaを示す。

【0069】また、特開昭51-37193号、特公平 2-32293号、特公平2-16765号に記載され ングリコールジイタコネート、ペンタエリスリトールジ 50 ているようなウレタンアクリレート類や、特公昭58-

49860号、特公昭56-17654号、特公昭62-39417、特公昭62-39418号記載のエチレンオキサイド系骨格を有するウレタン化合物類も好適である。

【0070】さらに、特開昭63-277653,特開昭63-260909号、特開平1-105238号に記載される、分子内にアミノ構造やスルフィド構造を有する付加重合性化合物類を用いることによっては、非常に感光スピードに優れた感光性組成物を得ることができる。

【0071】その他の例としては、特開昭48-64183号、特公昭49-43191号、特公昭52-30490号、各公報に記載されているようなポリエステルアクリレート類、エポキシ樹脂と(メタ)アクリル酸を反応させたエポキシアクリレート類等の多官能のアクリレートやメタクリレートをあげることができる。また、特公昭46-43946号、特公平1-40337号、特公平1-40336号記載の特定の不飽和化合物や、特開平2-25493号記載のピニルホスホン酸系化合物等もあげることができる。また、ある場合には、特開昭61-22048号記載のペルフルオロアルキル基を含有する構造が好適に使用される。さらに日本接着協会は、vol. 20、No. 7、300~308ページ(1984年)に光硬化性モノマーおよびオリゴマーとして紹介されているものも使用することができる。

【0072】これらの、付加重合性化合物について、ど の様な構造を用いるか、単独で使用するか併用するか、 添加量はどうかといった、使用方法の詳細は、最終的な 感材の性能設計にあわせて、任意に設定できる。例えば 次のような観点から選択される。感光スピードの点では 30 1分子あたりの不飽和基含量が多い構造が好ましく、多 くの場合、2官能以上が好ましい。また、画像部すなわ ち硬化膜の強度を高くするためには、3官能以上のもの が良く、さらに、異なる官能数・異なる重合性基 (例え ばアクリル酸エステル、メタクリル酸エステル、スチレ ン系化合物、ピニルエーテル系化合物) のものを併用す ることで、感光性と、強度を両方を調節する方法も有効 である。大きな分子量の化合物や、疎水性の高い化合物 は感光スピードや、膜強度に優れる反面、現像スピード や現像液中での析出といった点で好ましく無い場合があ 40 る。

【0073】また、感光性組成物中の他の成分(例えばバインダーポリマー、開始剤、着色剤等)との相溶性、分散性に対しても、付加重合化合物の選択・使用法は重要な要因であり、例えば、低純度化合物の使用や、2種以上の併用により相溶性を向上させうる事がある。また、平版印刷版用原版とする場合、後述の支持体、オーバーコート層等の密着性を向上せしめる目的で特定の構造を選択することもあり得る。感光性組成物中の付加重合性化合物の配合比に関しては、多い方が感度的に有利 50

であるが、多すぎる場合には、好ましく無い相分離が生じたり、感光性組成物の粘着性による製造工程上の問題 (例えば、感材成分の転写、粘着に由来する製造不良) や、平版印刷版用原版とした場合、現像液からの析出が生じる等の問題を生じうる。これらの観点から、好ましい配合比は、多くの場合、組成物全成分に対して5~80重量%、好ましくは25~75重量%である。また、これらは単独で用いても2種以上併用してもよい。そのほか、付加重合性化合物の使用法は、酸素に対する重合10阻害の大小、解像度、かぶり性、屈折率変化、表面粘着性等の観点から適切な構造、配合、添加量を任意に選択でき、さらに場合によっては下塗り、上塗りといった層構成・塗布方法も実施しうる。

【0074】(C)バインダーポリマー

本発明の好ましい実施形態である、平版印刷版用原版へ の適用に際しては、その感光層にさらにバインダーポリ マーを使用することが好ましい。バインダーとしては線 状有機高分子重合体を含有させることが好ましい。この ような「線状有機高分子重合体」としては、どれを使用 しても構わない。好ましくは水現像あるいは弱アルカリ 水現像を可能とする水あるいは弱アルカリ水可溶性また は膨潤性である線状有機高分子重合体が選択される。線 状有機高分子重合体は、組成物の皮膜形成剤としてだけ でなく、水、弱アルカリ水あるいは有機溶剤現像剤とし ての用途に応じて選択使用される。例えば、水可溶性有 機高分子重合体を用いると水現像が可能になる。このよ うな線状有機高分子重合体としては、側鎖にカルポン酸 基を有する付加重合体、例えば特開昭59-44615 号、特公昭54-34327号、特公昭58-1257 7号、特公昭54-25957号、特開昭54-927 23号、特開昭59-53836号、特開昭59-71 048号に記載されているもの、すなわち、メタクリル 酸共重合体、アクリル酸共重合体、イタコン酸共重合 体、クロトン酸共重合体、マレイン酸共重合体、部分エ ステル化マレイン酸共重合体等がある。また同様に側鎖 にカルボン酸基を有する酸性セルロース誘導体がある。 この他に水酸基を有する付加重合体に環状酸無水物を付 加させたものなどが有用である。

【0075】特にこれらの中で〔ベンジル(メタ)アクリレート/(メタ)アクリル酸/必要に応じてその他の付加重合性ビニルモノマー〕共重合体および〔アリル(メタ)アクリレート/(メタ)アクリル酸/必要に応じてその他の付加重合性ビニルモノマー〕共重合体は、膜強度、感度、現像性のバランスに優れており、好適である。

【0076】また、特公平7-12004号、特公平7-120041号、特公平7-120042号、特公平8-12424号、特開昭63-287944号、特開昭63-287944号、特開昭63-287947号、特開平10-116232号等に記載される、酸基を含

有するウレタン系パインダーポリマーは、非常に、強度 に優れるので、耐刷性・低露光適性の点で有利である。 【0077】また、特開平11-171907記載のア ミド基を有するパインダーは優れた現像性と膜強度をあ わせもち、好適である。

【0078】さらにこの他に水溶性線状有機高分子とし て、ポリピニルピロリドンやポリエチレンオキサイド等 が有用である。また硬化皮膜の強度を上げるためにアル コール可溶性ナイロンや2,2-ビス-(4-ヒドロキ シフェニル) - プロパンとエピクロロヒドリンのポリエ 10 酸素-酸素結合を有する化合物: 還元的に酸素-酸素結 ーテル等も有用である。これらの線状有機高分子重合体 は全組成物中に任意な量を混和させることができる。し かし90重量%を超える場合には形成される画像強度等 の点で好ましい結果を与えない。好ましくは30~85 重量%である。また光重合可能なエチレン性不飽和二重 結合を有する化合物と線状有機高分子重合体は、重量比 で1/9~7/3の範囲とするのが好ましい。

【0079】好ましい実施様態においてバインダーポリ マーは実質的に水不要でアルカリに可溶なものが用いら れる。そうすることで、現像液として、環境上好ましく 20 を生成しうる。 ない有機溶剤を用いないかもしくは非常に少ない使用量 に制限できる。この様な使用法においてはバインダーポ リマーの酸価 (ポリマー1gあたりの酸含率を化学等量 数で表したもの)と分子量は画像強度と現像性の観点か ら適宜選択される。好ましい酸価は、0.4~3.0m eq/gであり好ましい分子量は3000から50万の 範囲で、より好ましくは、酸価が0.6~2.0分子量 が1万から30万の範囲である。

【0080】(D) その他の成分

本発明の感光性組成物には、さらにその用途、製造方法 30 等に適したその他の成分を適宜添加することができる。 以下、好ましい添加剤に関し例示する。

(D1) 共增感剤

ある種の添加剤(以後、共増感剤という)を用いること で、感度をさらに向上させる事ができる。これらの作用 機構は、明確ではないが、多くは次のような化学プロセ スに基づくものと考えられる。即ち、先述の開始系の光 吸収により開始される光反応、と、それに引き続く付加 重合反応の過程で生じる様々な中間活性種 (ラジカル、 過酸化物、酸化剤、還元剤等)と、共増感剤が反応し、 新たな活性ラジカルを生成するものと推定される。これ らは、大きくは、(a) 還元されて活性ラジカルを生成 しうるもの、(b)酸化されて活性ラジカルを生成しう るもの、(c)活性の低いラジカルと反応し、より活性 の高いラジカルに変換するか、もしくは連鎖移動剤とし て作用するもの、に分類できるが、個々の化合物がこれ らのどれに属するかに関しては、通説がない場合も多

【0081】(a) 還元されて活性ラジカルを生成する 化合物

炭素-ハロゲン結合結合を有する化合物: 還元的に炭素 - ハロゲン結合が解裂し、活性ラジカルを発生すると考 えられる。具体的には、例えば、トリハロメチルーsー トリアジン類や、トリハロメチルオキサジアゾール類等 が好適に使用できる。

窒素-窒素結合を有する化合物: 還元的に窒素-窒素結 合が解裂し、活性ラジカルを発生すると考えられる。具 体的にはヘキサアリールピイミダゾール類等が好適に使 用される。

合が解裂し、活性ラジカルを発生すると考えられる。具 体的には、例えば、有機過酸化物類等が好適に使用され

オニウム化合物:還元的に炭素-ヘテロ結合や、酸素-窒素結合が解裂し、活性ラジカルを発生すると考えられ る。具体的には例えば、ジアリールヨードニウム塩類、 トリアリールスルホニウム塩類、N-アルコキシピリジ ニウム (アジニウム) 塩類等が好適に使用される。 フェロセン、鉄アレーン錯体類: 還元的に活性ラジカル

【0082】(b)酸化されて活性ラジカルを生成する 化合物

アルキルアート錯体:酸化的に炭素-ヘテロ結合が解裂 し、活性ラジカルを生成すると考えられる。具体的には 例えば、トリアリールアルキルポレート類が好適に使用 される。

アルキルアミン化合物:酸化により窒素に隣接した炭素 上のC-X結合が解裂し、活性ラジカルを生成するもの と考えられる。Xとしては、水索原子、カルボキシル 基、トリメチルシリル基、ベンジル基等が好適である。 具体的には、例えば、エタノールアミン類、N-フェニ ルグリシン類、N-トリメチルシリルメチルアニリン類 等があげられる。

含硫黄、含錫化合物:上述のアミン類の窒素原子を硫黄 原子、錫原子に置き換えたものが、同様の作用により活 性ラジカルを生成しうる。また、S-S結合を有する化 合物もS-S解裂による増感が知られる。

【0083】 α -置換メチルカルボニル化合物:酸化に より、カルポニルーα炭素間の結合解裂により、活性ラ 40 ジカルを生成しうる。また、カルボニルをオキシムエー テルに変換したものも同様の作用を示す。具体的には、 2 - P + V - 1 - [4 - (P + V + V + V)]-2-モルフォリノプロノン-1類、並びに、これら と、ヒドロキシアミン類とを反応したのち、N-OHを エーテル化したオキシムエーテル類をあげる事ができ

スルフィン酸塩類:還元的に活性ラジカルを生成しう る。具体的は、アリールスルフィン酸ナトリウム等をあ げる事ができる。

【0084】(c) ラジカルと反応し高活性ラジカルに

変換、もしくは連鎖移動剤として作用する化合物:例えば、分子内にSH、PH、SiH、GeHを有する化合物群が用いられる。これらは、低活性のラジカル種に水 案供与して、ラジカルを生成するか、もしくは、酸化された後、脱プロトンする事によりラジカルを生成しうる。具体的には、例えば、2-メルカプトペンズイミダソール類等があげられる。

*【0085】これらの共増感剤のより具体的な例は、例えば、特開昭9-236913中に、感度向上を目的とした添加剤として、多く記載されている。以下に、その一部を例示するが、本発明はこれらに限定されるものはない。

[0086] (化9]

【0087】これらの共増感剤に関しても、先の増感色素と同様、さらに、感光層の特性を改良するための様々な化学修飾を行うことも可能である。例えば、増感色素や活性剤、付加重合性不飽和化合物その他のパートとの結合、親水性部位の導入、相溶性向上、結晶析出抑制のための置換基導入、常40リマー化等の方法が利用できる。

【0088】これらの共増感剤は、単独でまたは2種以上併用して用いることができる。使用量はエチレン性不飽和二重結合を有する化合物100重量部に対し $0.05\sim100$ 重量部、好ましくは $1\sim80$ 重量部、さらに好ましくは $3\sim50$ 重量部の範囲が適当である。

【0089】 (D2) 重合禁止剤

また、本発明においては以上の基本成分の他に感光性組 成物の製造中あるいは保存中において重合可能なエチレ ン性不飽和二重結合を有する化合物の不要な熱重合を阻 50

止するために少量の熱重合防止剤を添加することが望ま しい。適当な熱重合防止剤としてはハイドロキノン、p ーメトキシフェノール、ジーtーブチルーp-クレゾー ル、ピロガロール、t-ブチルカテコール、ベンゾキノ ン、4, 4' -チオピス (3-メチル-6-t-プチルフェノール)、2,2′ーメチレンピス(4-メチルー 6-t-ブチルフェノール)、N-ニトロソフェニルヒ ドロキシアミン第一セリウム塩等が挙げられる。熱重合 防止剤の添加量は、全組成物の重量に対して約0.01 重量%~約5重量%が好ましい。また必要に応じて、酸 素による重合阻害を防止するためにベヘン酸やベヘン酸 アミドのような高級脂肪酸誘導体等を添加して、平版印 刷版用原版とする場合、支持体等への塗布後の乾燥の過 程でその感光層の表面に偏在させてもよい。高級脂肪酸 誘導体の添加量は、全組成物の約0.5重量%~約10 重量%が好ましい。

【0090】(D3) 潜色剤等

さらに、本発明の感光性組成物を平版印刷版用原版に用 いる場合、その感光層の着色を目的として染料もしくは 顔料を添加してもよい。これにより、印刷版としての、 製版後の視認性や、画像濃度測定機適性といったいわゆ る検版性を向上させる事ができる。着色剤としては、多 くの染料は光重合系感光層の感度の低下を生じるので、 着色剤としては、特に顔料の使用が好ましい。具体例と しては例えばフタロシアニン系顔料、アゾ系顔料、カー ット、クリスタルバイオレット、アゾ系染料、アントラ キノン系染料、シアニン系染料などの染料がある。染料 および顔料の添加量は全組成物の約0.5重量%~約5 重量%が好ましい。

【0091】(D4) その他の添加剤

さらに、本発明の感光性組成物を平版印刷版用原版に用 いる場合、硬化皮膜の物性を改良するために無機充填剤 や、その他可塑剤、感光層表面のインク着肉性を向上さ せうる感脂化剤等の公知の添加剤を加えてもよい。

【0092】可塑剤としては例えばジオクチルフタレー ト、ジドデシルフタレート、トリエチレングリコールジ カプリレート、ジメチルグリコールフタレート、トリク レジルホスフェート、ジオクチルアジペート、ジブチル セパケート、トリアセチルグリセリン等があり、結合剤 を使用した場合、エチレン性不飽和二重結合を有する化 合物と結合剤との合計重量に対し10重量%以下添加す ることができる。

【0093】また、後述する膜強度(耐刷性)向上を目 的とした、現像後の加熱・露光の効果を強化するため の、UV開始剤や、熱架橋剤等の添加もできる。

【0094】その他、感光層と支持体との密着性向上 や、未露光感光層の現像除去性を高めるための添加剤、 中間層を設ける事を可能である。例えば、ジアゾニウム 構造を有する化合物や、ホスホン化合物、等、基板と比 較的強い相互作用を有する化合物の添加や下塗りによ り、密着性が向上し、耐刷性を高める事が可能であり、 一方ポリアクリル酸や、ポリスルホン酸のような親水性 ポリマーの添加や下塗りにより、非画像部の現像性が向 上し、汚れ性の向上が可能となる。

【0095】平版印刷版を提供するために、本発明の感 光性組成物を支持体上に塗布する際には、種々の有機溶 剤に溶かして使用に供される。ここで使用する溶媒とし ては、アセトン、メチルエチルケトン、シクロヘキサ ン、酢酸エチル、エチレンジクロライド、テトラヒドロ フラン、トルエン、エチレングリコールモノメチルエー テル、エチレングリコールモノエチルエーテル、エチレ ングリコールジメチルエーテル、プロピレングリコール モノメチルエーテル、プロピレングリコールモノエチル エーテル、アセチルアセトン、シクロヘキサノン、ジア セトンアルコール、エチレングリコールモノメチルエー 50 8-18327号に記載されているようなポリエチレン

テルアセテート、エチレングリコールエチルエーテルア セテート、エチレングリコールモノイソプロピルエーテ ル、エチレングリコールモノブチルエーテルアセテー ١,

【0096】3-メトキシプロパノール、メトキシメト キシエタノール、ジエチレングリコールモノメチルエー テル、ジエチレングリコールモノエチルエーテル、ジエ チレングリコールジメチルエーテル、ジエチレングリコ ールジエチルエーテル、プロピレングリコールモノメチ ポンプラック、酸化チタンなどの顔料、エチルバイオレ 10 ルエーテルアセテート、プロピレングリコールモノエチ ルエーテルアセテート、3-メトキシプロピルアセテー ト、N, N-ジメチルホルムアミド、ジメチルスルホキ シド、γープチロラクトン、乳酸メチル、乳酸エチルな どがある。これらの溶媒は、単独あるいは混合して使用 することができる。そして、塗布溶液中の固形分の濃度 は、2~50重量%が適当である。

> 【0097】前記感光層の支持体被覆量は、主に、感光 層の感度、現像性、露光膜の強度・耐刷性に影響しうる もので、用途に応じ適宜選択することが望ましい。被覆 20 量が少なすぎる場合には、耐刷性が十分でなくなる。一 方多すぎる場合には、感度が下がり、露光に時間がかか る上、現像処理にもより長い時間を要するため好ましく ない。本発明の主要な目的である走査露光用平版印刷版 としては、その被覆量は乾燥後の重量で約0.1g/m 2~約10g/m2の範囲が適当である。より好ましくは $0.5 \sim 5 \text{ g/m}^2 \text{ cos}$

> 【0098】「支持体」本発明の主要な目的の一つであ る、平版印刷版を得るには上記感光層を、表面が親水性 の支持体上に設ける事が望ましい。親水性の支持体とし 30 ては、従来公知の、平版印刷版に使用される親水性支持 体を限定無く使用することができる。使用される支持体 は寸度的に安定な板状物であることが好ましく、例え ば、紙、プラスチック(例えば、ポリエチレン、ポリプ ロピレン、ポリスチレン等)がラミネートされた紙、金 属板 (例えば、アルミニウム、亜鉛、銅等) 、プラスチ ックフィルム(例えば、二酢酸セルロース、三酢酸セル ロース、プロピオン酸セルロース、酪酸セルロース、酢 酸酪酸セルロース、硝酸セルロース、ポリエチレンテレ フタレート、ポリエチレン、ポリスチレン、ポリプロピ レン、ポリカーポネート、ポリピニルアセタール等)、 上記の如き金属がラミネート若しくは蒸着された紙若し くはプラスチックフィルム等が含まれ、これらの表面に たいし、必要に応じ親水性の付与や、強度向上、等の目 的で適切な公知の物理的、化学的処理を施しても良い。 【0099】特に、好ましい支持体としては、紙、ポリ エステルフィルム又はアルミニウム板があげられ、その 中でも寸法安定性がよく、比較的安価であり、必要に応 じた表面処理により親水性や強度にすぐれた表面を提供 できるアルミニウム板は特に好ましい。また、特公昭4

テレフタレートフィルム上にアルミニウムシートが結合 された複合体シートも好ましい。好適なアルミニウム板 は、純アルミニウム板及びアルミニウムを主成分とし、 微量の異元素を含む合金板であり、更ノアルミニウムが ラミネート又は蒸着されたプラスチックフィルムでもよ い。アルミニウム合金に含まれる異元素には、ケイ素、 鉄、マンガン、銅、マグネシウム、クロム、亜鉛、ビス マス、ニッケル、チタン等がある。合金中の異元素の含 有量は高々10重量%以下である。本発明において特に 好適なアルミニウムは、純アルミニウムであるが、完全 10 に純粋なアルミニウムは精錬技術上製造が困難であるの で、僅かに異元素を含有するものでもよい。このように 本発明に適用されるアルミニウム板は、その組成が特定 されるものではなく、従来より公知公用の索材のAルミ ニウム板を適宜に利用することができる。本発明で用い られるアルミニウム板の厚みはおよそ0.1mm~0. 6mm程度、好ましくは0.15mm~0.4mm、特

【0100】また金属、特にアルミニウムの表面を有する支持体の場合には、粗面化(砂目立て)処理、珪酸ソーダ、弗化ジルコニウム酸カリウム、燐酸塩等の水溶液への浸润処理、あるいは陽極酸化処理などの表面処理がなされていることが好ましい。

に好ましくは0.2mm~0.3mmである。

【0101】アルミニウム板の表面の粗面化処理は、種々の方法により行われるが、例えば、機械的に粗面化する方法、電気化学的に表面を溶解粗面化する方法及び化学的に表面を選択溶解させる方法により行われる。機械的方法としては、ボール研磨法、ブラシ研磨法、ブラン研磨法、ブラスト研磨法、バフ、磨法等の公知の方法を用いることができる。また、電気化学的な粗面化法としては塩酸、硝酸等の電解液中で交流又は直流により行う方法がある。また、特開昭54-63902号に開示されているように両者を組み合わせた方法も利用することができる。また、アルミニウム板を粗面化するに先立ち、所望により、表面の圧延油を除去するために、例えば、界面活性剤、有機溶剤又はアルカリ性水溶液等による脱脂処理が行われる。

【0102】さらに、粗面化したのちに珪酸ナトリウム水溶液に浸漬処理されたアルミニウム板が好ましく使用できる。特公昭47-5125号に記載されているようにアルミニウム板を陽極酸化処理したのちに、アルカリ金属珪酸塩の水溶液に浸漬処理したものが好適に使用される。陽極酸化処理は、例えば、燐酸、クロム酸、硫酸、硼酸等の無機酸、もしくは蓚酸、スルファミン酸等の有機酸またはそれらの塩の水溶液または非水溶液の単独または二種以上を組み合わせた電解液中でアルミニウム板を陽極として電流を流すことにより実施される。

【0103】また、米国特許第3658662号に記載 らの内、ポリビニルアルコールを主成分として用いる事 されているようなシリケート電着も有効である。さら が、酸繁遮断性、現像除去性といった基本特性的にもっ に、特公昭46-27481号、特開昭52-5860 50 とも良好な結果を与える。保護層に使用するポリビニル

2号、特開昭52-30503号に開示されているような電解グレインを施した支持体と、上記陽極酸化処理および珪酸ソーダ処理を組合せた表面処理も有用である。【0104】また、特開昭56-28893号に開示されているような機械的粗面化、化学的エッチング、電解グレイン、陽極酸化処理さらに珪酸ソーダ処理を順に行ったものも好適である。さらに、これらの処理を行った後に、水溶性の樹脂、例えばポリピニルホスホン酸、スルホン酸基を側鎖に有する重合体および共重合体、ポリアクリル酸、水溶性金属塩(例えば硼酸亜鉛)もしくは、黄色染料、アミン塩等を下塗りしたものも好適である。

【0105】さらに特開平7-159983号に開示されているようなラジカルによって付加反応を起こし得る官能基を共有結合させたゾルーゲル処理基板も好適に用いられる。

【0106】その他好ましい例として、任意の支持体上に表面層として耐水性の親水性層を設けたものも上げることができる。この様な表面層としては例えばUS3055295や、特開昭56-13168号記載の無機顔料と結着剤とからなる層、特開平9-80744記載の親水性膨潤層、特表平8-507727記載の酸化チタン、ポリビニルアルコール、珪酸類からなるゾルゲル膜等を上げる事ができる。

【0107】これらの親水化処理は、支持体の表面を親水性とするために施される以外に、その上に設けられる 光重合性組成物の有害な反応を防ぐため、かつ感光層の 密着性の向上等のために施されるものである。

【0108】「保護層」本発明の望ましい様態である、走査露光用平版印刷版においては、通常、露光を大気中で行うため、光重合性組成物の層の上に、さらに、保護層を設ける事が好ましい。保護層は、感光層中で露光により生じる画像形成反応を阻害する大気中に存在する酸素、や塩基性物質等の低分子化合物の感光層への混入を防止し、大気中での露光を可能とする。従って、この様な保護層に望まれる特性は、酸素等の低分子化合物の透過性が低いことであり、さらに、露光に用いる光の透過は実質阻害せず、感光層との密着性に優れ、かつ、露光後の現像工程で容易に除去できる事が望ましい。

【0109】この様な、保護層に関する工夫が従来よりなされており、米国特許第3、458、311号、特開昭55-49729号に詳しく記載されている。保護層に使用できる材料としては例えば、比較的、結晶性に優れた水溶性高分子化合物を用いる事がよく、具体的には、ポリビニルアルコール、ポリビニルピロリドン、酸性セルロース類、ゼラチン、アラビアゴム、ポリアクリル酸などのような水溶性ポリマーが知られていが、これらの内、ポリビニルアルコールを主成分として用いる事が、酸繁遮断性、現像除去性といった基本特性的にもっとも良好な結果を与える。保護層に使用するポリビニル

アルコールは、必要な酸素遮断性と水溶性を有するため の、未置換ビニルアルコール単位を含有する限り、一部 がエステル、エーテル、およびアセタールで置換されて いても良い。また、同様に一部が他の共重合成分を有し ていても良い。

【0110】ポリビニルアルコールの具体例としては7 1~100%加水分解され、分子量が300から240 0の範囲のものをあげる事ができる。 具体的には、株式 会社クラレ製のPVA-105、PVA-110、PV A-124, PVA-124H, PVA-CS, PVA -CST, PVA-HC, PVA-203, PVA-2 04, PVA-205, PVA-210, PVA-21 7, PVA-220, PVA-224, PVA-217 EE, PVA-217E, PVA-220E, PVA-224E, PVA-405, PVA-420, PVA-613、L-8等があげられる。

【0111】保護層の成分(PVAの選択、添加剤の使 用)、塗布量等は、酸素遮断性・現像除去性の他、カブ リ性や密着性・耐傷性を考慮して選択される。一般には 使用するPVAの加水分解率が高い程(保護層中の未置 換ビニルアルコール単位含率が高い程)、膜厚が厚い程 酸素遮断性が高くなり、感度の点で有利である。しかし ながら、極端に酸素遮断性を高めると、製造時・生保存 時に不要な重合反応が生じたり、また画像露光時に、不 要なカブリ、画線の太りが生じたりという問題を生じ る。また、画像部との密着性や、耐傷性も版の取り扱い 上極めて重要である。即ち、水溶性ポリマーからなる親 水性の層を親油性の重合層に積層すると、接着力不足に よる膜剥離が発生しやすく、剥離部分が酸素の重合阻害 30 により膜硬化不良などの欠陥を引き起こす。

【0112】これに対し、これら2層間の接着性を改す べく種々の提案がなされている。たとえば米国特許第2 92、501号、米国特許第44、563号には、主に ポリビニルアルコールからなる親水性ポリマー中に、ア クリル系エマルジョンまたは水不溶性ピニルピロリドン ーピニルアセテート共重合体などを20~60重量%混 合し、重合層の上に積層することにより、十分な接着性 が得られることが記載されている。本発明における保護 層に対しては、これらの公知の技術をいずれも適用する 40 事ができる。このような保護層の塗布方法については、 例えば米国特許第3,458,311号、特開昭55-4 9729号に詳しく記載されている。

【0113】さらに、保護層に他の機能を付与する事も できる。例えば、露光に使う、350nmから450n mの光の透過性に優れ、かつ500nm以上の光を効率 良く吸収しうる、着色剤 (水溶性染料等) の添加によ り、感度低下を起こすことなく、セーフライト適性をさ らに高める事ができる。

画像形成材料として使用する際には、通常、画像露光し たのち、現像液で感光層の未露光部を除去し、画像を得 る。これらの光重合性組成物を平版印刷版の作成に使用 する際の好ましい現像液としては、特公昭57-742 7号に記載されているような現像液が挙げられ、ケイ酸 ナトリウム、ケイ酸カリウム、水酸化ナトリウム、水酸 化カリウム、水酸化リチウム、第三リン酸ナトリウム、 第二リン酸ナトリウム、第三リン酸アンモニウム、第二 リン酸アンモニウム、メタケイ酸ナトリウム、重炭酸ナ A-117、PVA-117H、PVA-120、PV 10 トリウム、アンモニア水などのような無機アルカリ剤や モノエタノールアミンまたはジエタノールアミンなどの ような有機アルカリ剤の水溶液が適当である。このよう なアルカリ溶液の濃度が0.1~10重量%、好ましく は0.5~5重量%になるように添加される。

> 【0115】また、このようなアルカリ性水溶液には、 必要に応じて界面活性剤やベンジルアルコール、2-フ ェノキシエタノール、2-ブトキシエタノールのような 有機溶媒を少量含むことができる。例えば、米国特許第 3375171号および同第3615480号に記載さ れているものを挙げることができる。さらに、特開昭5 0-26601号、同58-54341号、特公昭56 -39464号、同56-42860号の各公報に記載 されている現像液も優れている。

> 【0116】その他、本発明の感光性組成物を用いた平 版印刷版用原版の製版プロセスとしては、必要に応じ、 露光前、露光中、露光から現像までの間に、全面を加熱 しても良い。この様な加熱により、感光層中の画像形成 反応が促進され、感度や耐刷性の向上、や、感度の安定 化といった利点が生じ得る。さらに、画像強度・耐刷性 の向上を目的として、現像後の画像に対し、全面後加熱 もしくは、全面露光を行う事も有効である。通常現像前 の加熱は150℃以下の穏和な条件で行う事が好まし い。温度が高すぎると、非画像部迄がかぶってしまう等 の問題を生じる。現像後の加熱には非常に強い条件を利 用する。通常は200~500°Cの範囲である。温度が 低いと十分な画像強化作用が得られず、高すぎる場合に は支持体の劣化、画像部の熱分解といった問題を生じ る。

【0117】本発明の感光性組成物を用いた走査露光平 版印刷版の露光方法は、公知の方法を制限なく用いる事 ができる。望ましい、光源の波長は350 nmから45 0 nmであり、具体的には InGaN系半導体レーザが 好適である。露光機構は、内面ドラム方式、外面ドラム 方式、フラットペッド方式等の何れでも良い。また、本 発明の感光性組成物は、高い水溶性のものを使用する事 で、中性の水や弱アルカリ水に可溶とすることもできる が、この様な構成の平版印刷版用原版は印刷機上に装填 後、機上で露光ー現像といった方式を行う事もできる。 【0118】350nm~450nmの入手可能なレー 【0114】本発明の感光性組成物を用いた感光材料を 50 ザー光源としては以下のものを利用することができる。

場合

【0119】ガスレーザーとして、Arイオンレーザー $(364 nm, 351 nm, 10 mW \sim 1W), Kr4$ オンレーザー (356nm、351nm、10mW~1 W) $\text{He-Cd}\nu\text{-}\text{#}\text{-}\text{(441nm, 325nm,}$ 1mW~100mW)、固体レーザーとして、Nd:Y AG (YVO₄) とSHG結晶×2回の組み合わせ (3 55nm, 5mW~1W), Cr: LiSAF&SHG 結晶の組み合わせ (430 nm、10 mW)、

【0120】半導体レーザー系として、KNbO3リン グ共振器(430nm、30mW)、導波型波長変換索 10 子とAlGaAs、InGaAs半導体の組み合わせ (380nm~450nm、5mW~100mW)、導 波型波長変換素子とAIGaInP、AIGaAs半導 体の組み合わせ(300nm~350nm、5mW~1 00mW), AlGaInN (350nm~450n

その他、パルスレーザーとしてN2レーザー (337n m、パルス0.1~10mJ)、XeF (351nm、 パルス10~250mJ)

m, $5 mW \sim 30 mW$)

【0121】特にこの中でAlGaInN半導体レーザ 20 ー(市販InGaN系半導体レーザー400~410n m、5~30mW) が波長特性、コストの面で好適であ る。

【0122】また走査露光方式の平版印刷版露光装置と しては、露光機構として内面ドラム方式、外面ドラム方 式、フラットベッド方式があり、光源としては上記光源 の中で連続発振可能なものが好ましく利用することがで きる。現実的には感材感度と製版時間の関係で、以下の 露光装置が特に好ましい。

【0123】・内面ドラム方式で総出力20mW以上の 30 せが最も好ましいことになる。 半導体レーザーとなる様に、ガスレーザーあるいは固体 レーザー光源を1個以上使用するシングルビーム~トリ ブルビームの露光装置

・フラットペッド方式で総出力20mW以上となる様 に、半導体レーザー、ガスレーザーあるいは固体レーザ ーを1個以上使用したマルチピーム (1~10本) の露 光装置

・外面ドラム方式で総出力20mW以上となる様に、半 導体レーザー、ガスレーザーあるいは固体レーザーを1 個以上使用したマルチピーム (1~9本) の露光装置

・外面ドラム方式で総出力20mW以上となる様に、半 導体レーザーあるいは固体レーザーを1個以上使用した マルチピーム (10本以上) の露光装置

【0124】以上のようなレーザー直描型の平版印刷版 においては、一般に感材感度X(J/cm²)、感材の 露光面積S (cm²)、レーザー光源1個のパワーq (W)、レーザー本数n、全國光時間t(s)との間に 式 (eq 1) が成立する。

 $[0125] X \cdot S = n \cdot q \cdot t$ -- (eq 1)

レーザー回転数f(ラジアン/s)、感材の副走査長L x (cm)、解像度Z (ドット/cm)、全露光時間 t (s) の間には一般的に式 (e q 2) が成立する。

36

 $[0127] \mathbf{f} \cdot \mathbf{Z} \cdot \mathbf{t} = \mathbf{L} \mathbf{x}$ -- (eq 2) 【0128】ii)外面ドラム(マルチピーム)方式の場

ドラム回転数F(ラジアン/s)、感材の副走査長Lx (cm)、解像度Z(ドット/cm)、全露光時間t (s)、ビーム数(n)の間には一般的に式(eq 3) が成立する。

 $[0129] F \cdot Z \cdot n \cdot t = Lx -- (eq 3)$ 【0130】iii)フラットヘッド(マルチピーム)方 式の場合

ポリゴンミラーの回転数H(ラジアン/s)、感材の副 走査長Lx(cm)、解像度Z(ドット/cm)、全露 光時間t(s)、ビーム数(n)の間には一般的に式 (eq 4) が成立する。

 $[0131] F \cdot Z \cdot n \cdot t = Lx -- (eq 4)$ 【0132】実際の印刷版に要求される解像度(256 0dpi)、版サイズ (A1/B1、副走査長42in ch)、20枚/1時間程度の露光条件と本発明の感光 性組成物の感光特性(感光波長、感度:約0.1mJ/ c m²) を上記式に代入することで、本発明の感光性組 成物を用いた感材においては総出力20mW以上のレー ザーを用いたマルチビーム露光方式との組み合わせが特 に好ましいことが理解できる。さらに操作性、コスト等 を掛け合わせることにより外面ドラム方式の半導体レー ザーマルチピーム (10本以上) 露光装置との組み合わ

【0133】また、本発明の感光性組成物に対するその 他の露光光線としては、超高圧、高圧、中圧、低圧の各 水銀灯、ケミカルランプ、カーポンアーク灯、キセノン 灯、メタルハライド灯、可視および紫外の各種レーザー ランプ、蛍光灯、タングステン灯、太陽光等も使用でき る。また、本発明の感光性組成物の用途としては走査器 光用平版印刷版の他、広く、光硬化樹脂の用途として知 られるものに制限なく適用できる。例えば、必要に応じ カチオン重合性化合物と併用した液状の感光性組成物に 適用することで、高感度な光造形用材料が得られる。ま た、光重合にともなう、屈折率の変化を利用し、ホログ ラム材料とすることもできる。光重合に伴う、表面の粘 着性の変化を利用して様々な転写材料(剥離感材、トナ ー現像感材等) にも応用できる。マイクロカブセルの光 硬化にも適用できる。フォトレジスト等の電子材料製 造、インクや塗料、接着剤等の光硬化樹脂材料にも応用 できる。

[0134]

【実施例】以下、実施例によって本発明を説明するが、 【0126]i)内面ドラム(シングルビーム)方式の 50 本発明はこれらの実施例に限定されるものではない。

「実施例1から6、比較例1から6」

(支持体の調製) 厚さ 0.3 mmのアルミニウム板を1 0 重量%水酸化ナトリウムに60℃で25秒間浸漉して エッチングした後、流水で水洗後20重量%硝酸で中和 洗浄し、次いで水洗した。これを正弦波の交番波形電流 を用いて1重量%硝酸水溶液中で300クーロン/dm 2の陽極時電気量で電解粗面化処理を行った。引き続い て1重量%水酸化ナトリウム水溶液中に40℃で5秒間 浸漬後30重量%の硫酸水溶液中に浸漬し、60℃で4 0秒間デスマット処理した後、20重量%硫酸水溶液 *10

*中、電流密度2A/dm²において、陽極酸化皮膜の厚 さが2.7g/m²になるように、2分間陽極酸化処理 した。その表面粗さを測定したところ、0.3μm (J IS B0601によるRa表示) であった。

【0135】このように処理された基板の裏面に下記の ゾルーゲル反応液をパーコーターで塗布し100℃で1 分間乾燥し、乾燥後の塗布量が70mg/m²のバック コート層を設けた支持体を作成した。

[0136]

ゾルーゲル反応液

テトラエチルシリケート 水 メタノール

20重量部 15重量部

50重量部

リン酸

0.05 重量部

【0137】上記成分を混合、撹拌すると約5分で発熱 ※えることによりバックコート塗布液を調製した。 が開始した。60分間反応させた後、以下に示す液を加※ [0138]

ピロガロールホルムアルデヒド縮合樹脂(分子量2000)

4 重量部

ジメチルフタレート

5重量部

フッ索系界面活性剤(N-ブチルペルフルオロオクタン 0.7重量部

スルホンアミドエチルアクリレート/ポリオキシエチレンアクリレート共重

合体:分子量2万)

メタノールシリカゾル (日産化学工業(株)製,メタノール30重量%)

50重量部

メタノール

800重量部

1.5g

【0139】(感光層の調製)このように処理されたア ★分間乾燥させ感光層を形成させた。 ルミニウム板上に、下記組成の光重合性組成物を乾燥塗 [0140]

布量が1.0g/m²となるように塗布し、80℃、2 ★

・ペンタエリスリトールテトラアクリレート

・アリルメタクリレート/メタクリル酸共重合体

・(共重合モル比83/17) 2.0g

・光重合開始系 (表1中に記載)

增感色素

チタノセン化合物

共增感剤

・フッ索系ノニオン界面活性剤(F-177P)

 $0.02\,\mathrm{g}$

・熱重合禁止剤N-ニトロソフェニルヒドロキシル

 $0.01\,\mathrm{g}$

・着色顔料分散物

2.0g

(顔料分散物の組成)

組成: Pigment Blue 15:6 15重量部

アリルメタクリレート/メタクリル酸共重合体 10重量部

(共重合モル比83/17)

シクロヘキサノン

15重量部

メトキシプロピルアセテート

20重量部

プロピレングリコールモノメチルエーテル

40重量部

・メチルエチルケトン

20.0g

・プロピレングリコールモノメチルエーテル

20.0g

【0141】(保護層の調製)この感光層上にポリビニ ルアルコール(ケン化度98モル%、重合度550)の うに塗布し、100℃で2分間乾燥した。

【0142】(感光性、セーフライト適性の評価)この 3重量%の水溶液を乾燥塗布重量が2g/m²となるよ 50 様に得られた感材上に、富士写真フィルム(株)製の富

士ステップガイド (ΔD=0.15で不連続的に透過光 学濃度が変化するグレースケール)を密着させ、光学フ ィルター (ケンコーBP-40) を通したキセノンランプ を用い、既知の露光エネルギーとなるように露光を行っ た。光学フィルターとしては、短波半導体レーザへの露 光適性を見積もる目的で、400mmのモノクロミック な光で露光が可能なケンコーBP-40を用いた。その 後、下記組成の現像液に25℃、10秒間浸漉し、現像* *を行い、画像が完全に除去される最高の段数から感度 (クリア感度)を算出した(表1)。ここで、クリア感 度とは、画像の形成に最低限必要なエネルギーを表し、 この値が低いほど高感度である。比較例として、チタノ センのかわりにトリアジン化合物を用いた。

[0143]

【表1】

	5	クリア感度			
	增感色素	チタノセン化合物 共増盛剤		(mJ/cm^2)	
実施例1	D21(0.06)	T-1(0.06)	H1(0.2)	0.2	
実施例2	D10(0.1)	T-2(0.12)	H2(0.2)	0.1	
実施例3	D12(0.08)	T-2(0.06)	無し	0.3	
実施例 4	D11(0.08)	T-2(0.15)	H1(0.5)	0.2	
実施例 5	D20(0.05)	T-2(0.03)	無し	0.4	
実施例 6	D1(0.1)	T-1(0.1)	無し	0.1	
比較例 1	D4(0.2)	無し	無し	画像形成せず	
比較例2	無し	T-2(0.1)	無し	1.8	
比較例3	無し	T-2(0.15)	H1(0.2)	0.7	
比較例4	DR-2(0.05)	T-2(0.03)	無し	1.5	
比較例 5	DR-3(0.1)	T-1(0.1) 無し		1.1	
比較例 6	DR-1(0.08)	H3(0.06)*	無し	1.8	

【0144】表1に示すように、本発明の平版印刷版は 非常に高感度であり、走査露光方式に十分な感度を示 す。また、本発明の開始系は増感色素を使用しない場合 に比較して、高感度であり、特にチタノセンの添加量が 30 少ない場合においても、十分な感度を示す。

【0145】(実施例1から6、比較例1から6中の現 像液)

[0146]

下記組成からなる p H 1 3 の水溶液

1 Kケイ酸カリウム

3.0 重量部

水酸化カリウム

1.5 重量部

前記式3の化合物(ペレックスNBL; (花王アトラス(株)製))

0.2 重量部

水

95.3 重量部

【0148】「実施例7~14、比較例7」以下の手順 で平版印刷版を作製し、印刷性能を評価した。結果を表 2に示す。

「支持体の前処理」厚さ0.3mmの材質1Sのアルミ ニウム板を8号ナイロンブラシと800メッシュのパミ ストンの水懸濁液を用い、その表面を砂目だてした後。 よく水で洗浄した。10重量%水酸化ナトリウムに70 ℃で60秒間浸瀆してエッチングした後、流水で水洗 後、20重量%硝酸で中和洗浄し、次いで水洗した。こ

を用いて1重量%硝酸水溶液中で300クーロン/dm 2 の陽極時電気量で電解粗面化処理を行った。その表面 粗さを測定したところ、0.45μm (JIS B06 01によるRa表示)であった。

【0149】「支持体表面の親水化処理」上記の支持体 を、3号ケイ酸ソーダ (SiO₂=28~30%、Na₂ 0=9~10%、Fe=0.02%以下)の2.5重量 %、pH=11.2、70℃の水溶液に13秒浸漬し、 続いて水洗した。表面の蛍光X線分析により求めた、S れを V_A =12.7Vの条件で、正弦波の交番波形電流 50 i元索量から、表面シリケート量は $10 \,\mathrm{m\,g/m^2}$ と求

【化10】

(3)

ペレックスNBL;花王アトラス(株) 簑

[0147]

められた。

【0150】「中間層の塗設」上記の親水化支持体表面 上に、フェニルホスホン酸の塗布量が20mg/m²と なるようにように、下記 (A) に示す組成の塗布液を調 製し、ホイラーにて180rpmの条件で塗布後、80 ℃で30秒間乾燥させた。

(中間層塗布液A)

*フェニルホスホン酸 0.07g~1.4g

メタノール

200g

【0151】「感光層の塗設」上記中間層を設けた支持 体上に、下記組成の感光液を調製し、塗布量が1.0~ 2. 0g/m²になるように、ホイラーで塗布し、10 0℃で1分間乾燥させた。

[0152]

(感光液)

付加重合性化合物(表2中に記載の化合物) 1.5g バインダーポリマー (表2中に記載の化合物) 2. 0g 増感色素 (表2中に記載の化合物) 0.1g 活性剤(表2中に記載の化合物) 0.1g 共増感剤 (表2中に記載の化合物) 0.3g 着色顔料分散物 2.0g

(顔料分散物の組成)

Pigment Blue 15:6 15重量部 アリルメタクリレート/メタクリル酸共重合体 10重量部

(共重合モル比83/17) 熱重合

シクロヘキサノン 15重量部 メトキシプロビルアセテート 20重量部 プロピレングリコールモノメチルエーテル 40重量部

熱重合禁止剤(N-ニトロソフェニルヒドロキシルアミンアルミニウム塩

)

0.01g

界面活性剤 (大日本インキ化学工業 (株) 製、メガファックF-177)

0.02g

メチルエチルケトン

20.0g 20.0g

プロピレングリコールモノメチルエーテル

EOS-G(N)を使用した。ベタ画像部の印刷物を観 ルアルコール (ケン化度98モル%、重合度550)の 30 察し、画像がかすれはじめた枚数によって耐刷性を調べ た。数字が多きほど耐刷性が良い。

> 【0157】「網点耐刷性強制試験」印刷機としてロー ランド社製R201を使用し、インキとして大日本イン キ社製GEOS-G (N) を使用した。印刷開始から5 000枚目に富士写真フイルム(株) 製PSプレートク リーナーCL-2を印刷用スポンジにしみこませ、網点 部を拭き、版面のインキを洗浄した。その後、10,0 00枚印刷を行い、印刷物における網点の版飛びの有無 を目視で観察した。

【0158】「汚れ性試験」印刷機としてローランド社 製R201を使用し、インキとして大日本インキ社製G EOS-G(S)を使用した。非画像部(未露光部)の 印刷物を観察し、汚れ性を評価した。

[0159]

【表2】

【0153】「保護層の塗設」この感光層上にポリビニ 3重量%の水溶液を乾燥塗布重量が2g/m²となるよ うに塗布し、100℃で2分間乾燥した。

【0154】「平版印刷版原版の露光」上記のようにし て得られた平版印刷版原版を光源として、400mmの 単色光を用い、版面露光エネルギー密度200µJ/c m²となる様に露光パワーを調節し、ベタ画像露光およ び、175線/インチ、1%刻みで1から99%となる 網点画像露光、を行った。

【0155】「現像/製版」富士写真フィルム(株)製 自動現像機LP-850に所定の現像液(表2中に記 載)と富士写真フイルム(株)製フィニッシャーFP-2Wをそれぞれ仕込み現像液温度30℃、現像時間18 秒の条件で露光済みの版を、現像/製版し、平版印刷版 を得た。

【0156】「耐刷性試験」印刷機としてローランド社 製R201を使用し、インキとして大日本インキ社製G

10*NaOH滴定により求めた実測酸価1.55meq/g

ヘキサメチレンジイソシアネート (HMDI)

[0162] (B-3)

ウレタン樹脂

(PPG1000)

MPA) 40/10/15/35

ッド (DMPA)

[0163]

GPC測定より求めた重量平均分子量12.5万

下記ジイソシアネートとジオールの縮重合物であるポリ

4、4 '-ジフェニルメタンジイソイソシネート (MD

ポリプロピレングリコール、重量平均分子量1000

共重合モル比 (MDI/HMDI/PPG1000/D

NaOH滴定により求めた実測酸価1.05meq/g

GPC測定より求めた重量平均分子量4.5万

	感光層								印刷性能	
No	付加重合 性化合物	パインダー ポリマー	地感色素	チタノセン	共增感剂	塗布量 (mg/m2)	現像液組 成	画像部耐 刷性(枚)	福哈克爾 對傷	非国像部 汚れ性
実施例7	M-1	B-1	D-11	T-1	H-5	1.5	DV-1	100,000	良好	良好
実施例8	M-2	B-1	D-22	T-2	H-5	2	DV-2	70,000	良好	良好
実施例9	M-2	B-3	D-1	T-2	H-2	1.8	DV-3	200,000	良好	良好
実施例10		B-2	D-26	T-2	H-2	2.5	DV-1	80,000	良好	良好
実施例11	M-1	B-1	D-16	T-1	H-2	1	DV-1	70,000	良好	良好
実施例12		B-3	D-10	T-1	H-2	1	DV-3	50,000	良好	良好
実施例13		B-3	D-20	T-2	H-4	2.5	DV-3	50,000	良好	良好
実施例14		B-1	D-21	T-1	H-5	1.8	DV-1	80,000	良好	良好
比較例7	M-1	B-1	無し	T-2	H-2	1.5	DV-1	国像液れ	画像流れ	良好

【0160】 (表2中の付加重合性化合物)

(M-1)

ペンタエルスリトールテトラアクリレート (新中村化学 工業 (株) 製; NKエステルA-TMMT)

(M-2)

グリセリンジメタクリレートヘキサメチレンジイソシア ネートウレタンプレポリマー (共栄社化学(株)製; U A 1 0 1 H)

【0161】 (表1中のバインダーポリマー)

(B-1)

アリルメタクリレート/メタクリル酸/N-イソプロピ 20 2、2-ピス (ヒドロキシメチル) プロピオニックアシルアクリルアミド (共重合モル比67/13/20)

NaOH滴定により求めた実測酸価1.15meq/g

GPC測定より求めた重量平均分子量13万

(B-2)

アリルメタクリレート/メタクリル酸共重合体 (共重合 モル比83/17)

(表2中の現像液)

(DV-1)

下記組成からなる p H 1 0 の水溶液

モノエタノールアミン

0.1 重量部

トリエタノールアミン

1.5 重量部

下記式3の化合物 (ペレックスNBL; 花王アトラス (株) 製)

4.0 重量部

下記式4の化合物 (ニューコールB4SN;日本乳化剤(株)製)

2.5 重量部

下記式5の化合物

0.2 重量部

水

91.7 重量部

[0164] 【化11】

* [0165]

46

ペレックスNBL;花王アトラス(株) 袋

・コール日48N;日本乳化剤(棒) 臘

$$NaO_2C$$
 NaO_2C
 N

(DV-2)

下記組成からなるpH10の水溶液

炭酸水素ナトリウム

1.2 重量部

炭酸ナトリウム

0.8 重量部

上記式3の化合物(ペレックスNBL;花王アトラス(株)製)

3.0 重量部

上記式4の化合物 (ニューコールB4SN;日本乳化剤(株)製)

2.0 重量部

上記式5の化合物

0.2 重量部

水

92.8 重量部

[0166] (DV-3)

下記組成からなる p H 1 3 の水溶液

1 Kケイ酸カリウム

3.0 重量部

水酸化カリウム

1.5 重量部

前記式5の化合物

0.2 重量部

水

95.3 重量部

【0167】表2から明らかな様に、本発明による平版 印刷版は走査露光により高い生産性をもって製版可能な 条件、即ち、非常に低エネルギーの露光条件によって も、優れた平版印刷版を提供する。一方、本発明の開始 系を用いない、比較例7では、実用可能な平版印刷版は 40 得られなかった。

【0168】「実施例15」開始系を下記のような組成 に変え、光重合層の膜厚を1.5g/m²に変えた以外 は実施例1~6と同様に、平版印刷版原版を調製した。

[0169]

開始系 光重合層全固形分中の含有量

増感色素 D 2 0 1. 2 wt%

チタノセン T-2 1. 5 wt%

共增感剤 H-1 7. 0 wt%

【0170】得られた平版印刷版原版に対し、発振波長 50

30 400 nmのInGaN系半導体レーザを用い、版面で のピーム系25μm、露光エネルギー密度0.2mJ/ cm²となる条件で、走査露光を行った。次に、版を1 00℃で、10秒間加熱後、先述の現像処理を実施し た。視認性に優れた、青色の画像を有する平版印刷版が 得られた。得られた版を用い、ハイデルベルグ社KOR -D機を用い、オフセット印刷を実施したところ、画像 濃度、汚れ性に優れた印刷物を5万枚以上得ることがで きた。

【0171】「実施例16」実施例15の版を、温度6 5%、45℃の強制保存条件下で3日間保存後、実施例 15と同様に、製版・印刷を実施した。実施例15と同 様の良好な結果が得られた。

【0172】「実施例17」一般的に用いられる、セー フライトの発光強度分布を測定し、短波側での発光強度 分布の立ち上がる位置 (短波端) を測定した。また、そ れぞれのセーフライト下での作業性を評価した。結果を 表3に示す。

[0173]

【表3】

48

1227		
セーフライ	発光の短波	作業性
١	端	
白色灯	400 nm	良好。
黄色灯	520 nm	製版作業上十分な明るさである。
オレンジ灯	570nm	かなり暗く、作業しにくい。作業になれるまでに 時間を要する。
+ 42 102	000	非常にくらい。作業には熱線を要する
赤色灯	600nm	非形にくらい。 作来には 恋様を女りも

【0174】この様に、作業性を考慮すると黄色灯が望 10 黄色灯下に30分間さらした後、全く同様に製版・印刷 まれ、黄色灯下での取り扱い可能な感材は、少なくとも 520nm、望ましく490nmより長波での感光性が 低い事が必要であるが、本発明の色累群は400mm付 近に吸収極大を持つために、この点でも利点を持つ。

【0175】「実施例18」開始系を下記のような組成 に変え、光重合層の膜厚を2.0g/m²に変えた以外 は実施例15と同様に、平版印刷版原版を調製した。 [0176]

開始系

光重合層全固形分中の含有量

増感色素 D 2 0 1. 5 wt%

チタノセン T-2

1. 5 wt%

共增感剤 H-1 5. 0 wt%

【0177】得られた平版印刷版原版に対し、発振波長 400nmのInGaN系半導体レーザを用い、版面で のピーム系25µm、露光エネルギー密度0.15mJ /cm²となる条件で、走査露光を行った。次に、版を 100℃で、10秒間加熱後、先述の現像処理を実施し た。視認性に優れた、青色の画像を有する平版印刷版が 得られた。得られた版を、さらに、300℃で5分間加 熱後、ハイデルベルグ社KOR-D機を用い、オフセッ ト印刷を実施したところ、画像濃度、汚れ性に優れた印 刷物を20万枚以上得ることができた。

【0178】「実施例19」実施例18の版を露光前に

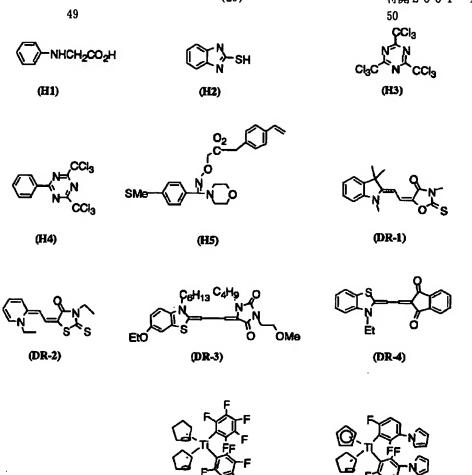
を実施した。実施例18と全く同様の良好な結果が得ら れた。

【0179】「比較例8」実施例15において増感色素 をD20 (極大吸収波長395nm) からDR-4 (極大吸 収波長500nm) に変えた以外は、実施例15と同様 にして平版印刷版原版を調製した。得られた平版印刷版 原版を、実施例15と同様に、発振波長400nmのI nGaN系半導体レーザを用いて製版してみたところ、 画像流れという結果になった。また、得られた平版印刷 20 版原版を実施例19と同様にして、露光前に黄色灯下に 30分間さらした後、全く同様に製版・印刷を実施した ところ、全面ベタとなり、カブリが発生した。

【0180】「比較例9」実施例15において、レーザ 一をFD-YAG (532nm) に変えた以外は実施例 15と同様に製版してみたところ、クリア感度が1.8 mJ/cm2の画像が得られた。しかし、得られた平版 印刷版原版を実施例19と同様にして、露光前に黄色灯 下に30分間さらした後、全く同様に製版・印刷を実施 したところ、全面ベタとなり、カブリが発生した。な お、本実施例中の増感色素は本明細鸖中に例示したもの であり、その他の化合物の構造は以下の通りである。

[0181]

【化12】



(T-1)

[0182]

原版の感光層に用いることによりInGaNの様な短波 長の半導体レーザによる走査露光に適した十分な感度を 有し、かつ耐刷性・汚れ性に優れたものとすることがで きる。本発明の感光性組成物を感光層に用いた走査露光*

*用平版印刷版は黄色灯下でのカブリが著しく改良されて 【発明の効果】本発明の感光性組成物は、平版印刷版用 30 おり、版を取り扱う作業性が大幅に改善する事ができ る。本発明の感光性組成物は350~450 nmの波長 に対して優れた感度を有すると同時に、非常に保存安定 性に優れたものである。

フロントページの続き

Fターム(参考) 2H025 AB03 AC01 AC08 AD01 AD03 BC14 BC43 BE07 BE10 BG00 CA01 CA17 CA22 CA39 2H096 AA07 BA05 BA06 BA11 EA02 **EA04** 4J011 ACO4 PA69 PA70 PB22 PC02 QA02 QA03 QA06 QA08 QA09 QA13 QA17 QA19 QA24 QA25 QB12 QB15 RA03 RA04 RA12 RA15 SA85 SA88 TA07 UA02 VA01 VA02 WA01 WA02 WA05

WA06 WA10